

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2001 年 8 月 2 日 (02.08.2001)

PCT

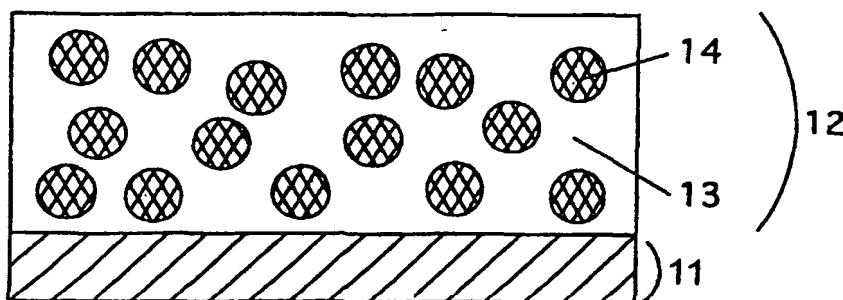
(10) 国際公開番号
WO 01/55753 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G02B 5/30, G02F 1/1335
- (21) 国際出願番号: PCT/JP01/00563
- (22) 国際出願日: 2001 年 1 月 29 日 (29.01.2001)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2000-18763 2000 年 1 月 27 日 (27.01.2000) JP
特願2000-53991 2000 年 2 月 29 日 (29.02.2000) JP
特願2000-95399 2000 年 3 月 30 日 (30.03.2000) JP
特願2000-116529 2000 年 4 月 18 日 (18.04.2000) JP
特願2000-292760 2000 年 9 月 26 日 (26.09.2000) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 富士写真フイルム株式会社 (FUJI PHOTO FILM CO., LTD.) [JP/JP]; 〒250-0123 神奈川県南足柄市中沼210番地 Kanagawa (JP).
- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 伊藤洋士 (ITO, Yoji) [JP/JP]. 網中英一郎 (AMINAKA, Eiichiro) [JP/JP]. 網盛一郎 (AMIMORI, Ichiro) [JP/JP]; 〒250-0123 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真フイルム株式会社内 Kanagawa (JP).
- (74) 代理人: 柳川泰男 (YANAGAWA, Yasuo); 〒160-0004 東京都新宿区四谷2-14 ミツヤ四谷ビル8階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM,

[続葉有]

(54) Title: SHEET POLARIZER ON WHICH LIGHT-SCATTERING POLARIZING ELEMENT AND LIGHT-ABSORPTION POLARIZING ELEMENT ARE PROVIDED IN MULTIYEAR

(54) 発明の名称: 光散乱型偏光素子と光吸収型偏光素子とが積層されている偏光板



(57) Abstract: A sheet polarizer on which a light-scattering polarizing element and a light-absorption polarizing element are provided in multilayer. The polarized light passing axis of the light-scattering polarizing element is substantially parallel to the polarized light passing axis of the light-absorption polarizing element. A polarized light selecting layer of a light-scattering polarized light selecting element comprises an optically isotropic continuous phase

and an optically isotropic continuous phase.

(57) 要約:

本発明の偏光板は、光散乱型偏光素子と光吸収型偏光素子とが積層されている。光散乱型偏光素子の偏光透過軸と光吸収型偏光素子の偏光透過軸とは、実質的に平行となるように配置する。光散乱型偏光選択素子の偏光選択層は、光学的等方性連続相と光学的異方性不連続相とからなる。



AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許
(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,
LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG,
CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書

明 細 書

光散乱型偏光素子と光吸収型偏光素子とが積層されている偏光板

[技術分野]

本発明は、所定の偏光を選択的に透過し、他の偏光を選択的に反射または散乱する偏光選択層を有する光散乱型偏光素子と、所定の偏光を選択的に透過し、他の偏光を選択的に吸収する偏光選択層を有する光吸収型偏光素子とが積層されている偏光板に関する。

また本発明は、偏光板を用いて光の利用効率を改善した画像表示装置にも関する。

さらに本発明は、光散乱型偏光素子として有利に用いられる光学フィルムにも関する。

[従来技術]

太陽光のような自然光やランプのような通常の人為的光源からの光は無偏光（ランダム偏光）であるが、偏光板を用いることで偏光（直線偏光、円偏光、楕円偏光）成分を取り出すことができる。取り出した偏光は、様々な光学機器に利用できる。現在広く普及している液晶表示装置は、偏光の性質を利用して画像を表示する装置であるとも言える。

広義の偏光板には、直線偏光板、円偏光板および楕円偏光板が含まれる。ただし、通常（狭義）の偏光板は、直線偏光板を意味する。本明細書においても、特に規定しない「偏光板」は、直線偏光板を意味する。直線偏光板は、最も基本的な偏光板である。

直線偏光板としては、一般にポリビニルアルコール系フィルムからなる光吸収型偏光素子が用いられている。ポリビニルアルコール系偏光素子は、ポリビニルアルコール系フィルムを延伸しヨウ素または二色性染料を吸着することにより製造する。偏光素子の透過軸（偏光軸）は、フィルムの延伸方向に垂直な方向に相当する。

光吸収型偏光素子は、偏光軸に平行な偏光成分のみを透過して、それと直交方向の偏光成分を吸収する。従って、光の利用効率は、理論的に50%（実際にはさらに低い値）以下である。

偏光素子の光の利用効率を向上させるため、光吸収型偏光素子に代えて、光散乱型偏光素子を使用することが提案されている。光散乱型偏光素子も、光吸収型偏光素子と同様に、偏光軸と平行な偏光成分のみを透過する。ただし、光散乱型偏光素子では、偏光軸と直交方向の偏光成分を吸収せずに前方もしくは後方に散乱し、偏光素子の光の利用効率を向上させる。

光散乱型偏光素子については、特開平8-76114号、同9-274108号、同9-297204号、特表平11-502036号、同11-509014号の各公報および米国特許5783120号、同5825543号、同5867316号の各明細書に記載がある。

[発明の要旨]

本発明の目的は、光の利用効率を向上させることができる偏光板を提供することである。

本発明の別の目的は、明るい表示画像が得られる液晶表示装置を提供することでもある。

さらに本発明の目的は、散乱特性の制御が容易であり、かつ大面積にわたって均一かつ大きな散乱特性を示す光学フィルムを提供することである。

本発明は、所定の偏光を選択的に透過し他の偏光を選択的に反射または散乱する偏光選択層を有する光散乱型偏光素子と、所定の偏光を選択的に透過し他の偏光を選択的に吸収する偏光選択層を有する光吸収型偏光素子とが積層されており、光散乱型偏光素子の偏光透過軸と光吸収型偏光素子の偏光透過軸とが実質的に平行となるように配置されており、そして、光散乱型偏光選択素子の偏光選択層が光学的等方性連続相と光学的異方性不連続相とからなることを特徴とする偏光板を提供する。

また、本発明は、バックライト、偏光板、ツイストネマチック配向モードの液晶セル、そして偏光板が、この順に積層されている液晶表示装置であって、バック

クライト側の偏光板が、バックライト側から順に、所定の偏光を選択的に透過し他の偏光を選択的に反射または散乱する偏光選択層を有する光散乱型偏光素子と、所定の偏光を選択的に透過し他の偏光を選択的に吸収する偏光選択層を有する光吸収型偏光素子とが積層されており、光散乱型偏光素子の偏光透過軸と光吸収型偏光素子の偏光透過軸とが実質的に平行となるように配置されており、そして、光散乱型偏光選択素子の偏光選択層が光学的等方性連続相と光学的異方性不連続相とからなる液晶表示装置を提供する。

さらに、本発明は、バックライト、偏光板、ベンド配向モードの液晶セル、そして偏光板が、この順に積層されている液晶表示装置であって、バックライト側の偏光板が、バックライト側から順に、所定の偏光を選択的に透過し他の偏光を選択的に反射または散乱する偏光選択層を有する光散乱型偏光素子と、所定の偏光を選択的に透過し他の偏光を選択的に吸収する偏光選択層を有する光吸収型偏光素子とが積層されており、光散乱型偏光素子の偏光透過軸と光吸収型偏光素子の偏光透過軸とが実質的に平行となるように配置されており、そして、光散乱型偏光選択素子の偏光選択層が光学的等方性連続相と光学的異方性不連続相とからなる液晶表示装置を提供する。

さらにまた、本発明は、バックライト、偏光板、水平配向モードの液晶セル、そして偏光板が、この順に積層されている液晶表示装置であって、バックライト側の偏光板が、バックライト側から順に、所定の偏光を選択的に透過し他の偏光を選択的に反射または散乱する偏光選択層を有する光散乱型偏光素子と、所定の偏光を選択的に透過し他の偏光を選択的に吸収する偏光選択層を有する光吸収型偏光素子とが積層されており、光散乱型偏光素子の偏光透過軸と光吸収型偏光素子の偏光透過軸とが実質的に平行となるように配置されており、そして、光散乱型偏光選択素子の偏光選択層が光学的等方性連続相と光学的異方性不連続相とからなる液晶表示装置を提供する。

そして、本発明は、透明支持体上に、所定の偏光を選択的に透過し、他の偏光を選択的に反射または散乱する偏光選択層が形成されている光学フィルムであって、偏光選択層が光学的等方性連続相と光学的異方性不連続相とからなり、フィルム面に垂直な偏光面において、最大の全光線透過率が75%以上であり、最小

の全光線透過率が60%未満であることを特徴とする光学フィルムも提供する。

なお、本明細書において、「実質的に垂直」、「実質的に平行」あるいは「実質的に45°」とは、厳密な角度よりも $\pm 5^\circ$ 未満の範囲内であることを意味する。この範囲は、 $\pm 4^\circ$ 未満であることが好ましく、 $\pm 3^\circ$ 未満であることがさらに好ましく、 $\pm 2^\circ$ 未満であることが最も好ましい。

また、本明細書において、「遅相軸(slow axis)」は屈折率が最大となる方向を、そして「透過軸(transmission axis)」は透過率が最大となる方向をそれぞれ意味する。

[図面の簡単な説明]

図1は、光学フィルムの基本的な構成を示す断面模式図である。

図2は、光吸収型偏光素子のみを用いた従来の液晶表示装置を示す断面模式図である。

図3は、光吸収型偏光素子と光散乱型偏光素子とを積層せずに用いた液晶表示装置を示す断面模式図である。

図4は、光吸収型偏光素子と光散乱型偏光素子とを積層した偏光板を用いた液晶表示装置を示す断面模式図である。

図5は、光吸収型偏光素子と光散乱型偏光素子とを積層した偏光板を用いた別の液晶表示装置を示す断面模式図である。

[発明の実施の形態]

(光散乱型偏光素子による光の利用効率改善)

光散乱型偏光素子による光の利用効率改善の機構として、下記(A)～(C)が提案されている。いずれも、本発明に応用できる。

(A) 前方散乱光の偏光解消

光散乱型偏光素子では、偏光軸と直交方向の偏光成分は前方もしくは後方に散乱される。このうち前方散乱された光が偏光解消され、前方散乱光の偏光方向が入射光の偏光方向から回転することにより、光散乱型偏光素子の偏光軸方向の偏光成分が入射光よりも増加する。光散乱型偏光子において、厚み方向に多数の粒

子が存在する場合には、多重散乱により偏光解消の程度が強くなる。このように、散乱型偏光板を使用する場合には、前方散乱光の偏光解消により光吸収型偏光板のみを使用する場合よりも光の利用効率が向上する。

(B) 後方散乱光の再利用（偏光解消）によるもの

光散乱型偏光素子の偏光軸と直交方向の偏光成分のうち後方散乱された光は、後方散乱される際に偏光解消される。後方散乱された光は、光源であるバックライトの背面に配置された金属反射板により反射され、再度光散乱型偏光素子へ入射する。ここで、再入射する光は後方散乱する際に偏光解消を受け、散乱型偏光板の偏光軸と平行方向の偏光成分が生じており、この偏光成分は散乱型偏光子を透過する。このように、光散乱型偏光子による後方散乱と金属反射板での反射を繰り返すことにより光の利用効率を向上させることができる。

(C) 後方散乱光の再利用（偏光方向の回転）

$\lambda/4$ 板と金属反射板とを配置した光学系に、 $\lambda/4$ 板の遅相軸と 45° をなすように直線偏光を入射させると、偏光方向が入射光と 90° 回転した反射光が戻ってくる。光散乱型偏光素子と金属反射板（バックライトの背面に配置される）との間に、 $\lambda/4$ 板を光散乱型偏光素子の偏光軸と $\lambda/4$ 板の遅相軸が 45° をなすように配置することによって上記と同じ効果が得られる。

光散乱型偏光素子において後方散乱された光の偏光方向の分布は、光散乱型偏光素子の偏光軸と直交方向が大きい。この後方散乱された光が $\lambda/4$ 板を透過して金属反射板により反射され再度、光散乱型偏光素子に入射する光の偏光方向の分布は、光散乱型偏光素子の偏光軸に平行方向に大きくなっており、偏光軸に平行な偏光成分は光散乱型偏光素子を透過する。このように、光散乱型偏光素子と金属反射板との間に $\lambda/4$ 板を配置することにより、光の利用効率を向上させることができる。

(光学フィルムおよび液晶表示装置の構成)

図 1 は、光学フィルムの基本的な構成を示す断面模式図である。

図 1 に示す光学フィルムでは、透明支持体 (11) 上において、偏光選択層 (12) が光学的等方性連続相 (13) と光学的異方性不連続相 (14) とに相分

離している。不連続相（１４）は複屈折を有する光学異方性化合物からなる。不連続相の二つの屈折率（ n_1 および n_2 ）は、用いる光学的異方性化合物の性質あるいは不連続相内における配向度により異なる。

図１に示す光学フィルムが、光散乱型偏光素子として機能するためには、光学的異方性不連続相（１４）の二つの屈折率（ n_1 および n_2 ）の一方が、光学的等方性連続相の屈折率と実質的に等しい値、すなわち０．０５未満となる必要がある。屈折率が実質的に等しくなる屈折率（ n_1 または n_2 ）の方向が、偏光選択層の透過軸に相当する。

図２は、光吸収型偏光素子のみを用いた従来の液晶表示装置を示す断面模式図である。

図２に示す液晶表示装置は、光源として最裏面にエッジライト方式のバックライト光源（２１）を配置し、裏面より順に、バックライトの光を表面に出射させる反射板（２２）および導光板（２３）を有する。導光板を用いない直下型バックライト使用タイプの液晶表示装置もある。

光源の上には、両側を２枚の光吸収型偏光素子（２４、２５）により挟持されてなる液晶セル（２６）が配置されている。２枚の光吸収型偏光素子と液晶セルとの組み合わせにより、画像を表示する。光源（２１）から出射された光は、下側の光吸収型偏光素子（２４）によって、少なくとも５０％吸収される。

図３は、光吸収型偏光素子と光散乱型偏光素子とを積層せずに用いた液晶表示装置を示す断面模式図である。

図３に示す液晶表示装置では、図２に示す液晶表示装置に、光散乱型偏光素子（３１）を追加した構成を有する。光散乱型偏光素子（３１）によって、下側の光吸収型偏光素子（２４）の透過軸と同じ方向の偏光は選択的に透過し、透過軸と直交する偏光の一部は前方散乱による偏光解消によって偏光面が透過軸方向に揃えられることにより利用効率が向上する。また、透過軸と直交する偏光の一部は、後方散乱によって光源（２１）側へ戻り、導光板（２３）により偏光解消されて反射板（２２）で反射され、再び光散乱型偏光素子（３１）に戻って再利用されることによって、利用効率が向上する。

図３に示す液晶表示装置では、光吸収型偏光素子（２４）と光散乱型偏光素子

(31) とを積層していないが、これらを積層した偏光板として用いることで、光の利用効率をさらに改善することができる。

図4は、光吸収型偏光素子と光散乱型偏光素子とを積層した偏光板を用いた液晶表示装置を示す断面模式図である。

図4に示す液晶表示装置では、光源(21)から出射され、反射板(22)および導光板(23)を経由した光は散乱シート(33)により面内で輝度が均一化され、光を所定方向に集光する機能を有する集光性フィルム(34)により、ユーザが見ることの無い極端に斜め方向の光を正面付近に集光させて利用効率を向上させる。集光性フィルム(34)では逆にユーザが見る可能性のある正面よりやや斜め方向の光を減少させるが、光吸収型偏光素子(24)と光散乱型偏光素子(31)とを積層した偏光板(32)によって適度に拡散される。光吸収型偏光素子(24)と光散乱型偏光素子(31)とを積層した偏光板(32)は、さらに図3に示す液晶表示装置と同様の原理で輝度を向上させる。以上の結果、自然な輝度の視野角分布が得られることになる。

図3に示す液晶表示装置は、光散乱型偏光素子(31)の偏光選択層とは反対側の面および光吸収型偏光素子(24)の表面で反射があるため、光の利用効率が約10%減少する。一方、図4に示す液晶表示装置では、光吸収型偏光素子(24)と光散乱型偏光素子(31)とを積層した偏光板(32)を用いることで、これらの反射面が無くなり、それだけでも光の利用効率は約10%増加する。

図5は、光吸収型偏光素子と光散乱型偏光素子とを積層した偏光板を用いた別の液晶表示装置を示す断面模式図である。

図5に示す液晶表示装置では、光吸収型偏光素子(24)と光散乱型偏光素子(31)とを積層した偏光板(32)の輝度向上機能が、さらに改善されている。光散乱型偏光素子(31)の偏光選択層表面に直接または他の層を介して反射防止層(35)を設けることにより、表面での反射を減少させ、偏光選択層内に入射する光量を増加させることができる。さらに前記(C)の後方散乱光の再利用(偏光方向の回転)で述べたように、偏光板(32)の下側に $\lambda/4$ 板(36)を用いることにより、後方散乱された光散乱型偏光素子(31)の透過軸と直交する偏光が2度 $\lambda/4$ 板(36)を通過して、光散乱型偏光素子(31)の透

過軸に偏光面を有するように回転され、光の利用効率が著しく改善される。その他の光源（２１）、反射板（２２）、導光板（２３）、散乱シート（３３）および集光性フィルム（３４）の機能は、図４に示す液晶表示装置と同様である。

（透明支持体）

偏光板は、少なくとも一枚の透明支持体を有することが好ましい。一枚の透明支持体を光散乱型偏光素子と光吸収型偏光素子とで共有することもできる。また、光散乱型偏光素子と光吸収型偏光素子とが、それぞれ透明支持体を有することもできる。また、光散乱型偏光素子または光吸収型偏光素子の偏光選択層の両面を、二枚の透明支持体で保護してもよい。

透明支持体が「透明」であるとは、光線透過率が８０％以上であることを意味する。また、透明支持体は、正面から見たときに光学的等方性を有することが好ましい。従って、透明支持体は小さい固有複屈折を有する材料から形成することが好ましい。ただし、固有複屈折の大きい素材（例、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリアリレート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン）であっても、フィルム製造（例えば、溶液流延や溶融押し出し）条件、あるいは縦、横方向の延伸条件を適宜調節することによって、光学的等方性のフィルムを得ることができる。

透明支持体としては、ガラス板またはポリマーフィルムを用いることができる。ポリマーフィルムが好ましい。フィルムを形成するポリマーの例には、ポリオレフィン（例、ポリエチレン）、ノルボルネン樹脂、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリスチレン（例、シンジオタクチックポリスチレン）、ポリアリレート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリ塩化ビニル、ポリビニルアルコール、セルロースエステル（例、セルロースアセテート）が含まれる。二種類以上のポリマーを混合したフィルムを用いてもよい。市販のポリマー（例、ゼオネックス、日本ゼオン（株）製；ARTON、JSR（株）製；フジタック（富士写真フィルム（株）製）を使用することもできる。

透明支持体は、偏光選択層（特に光吸収型偏光素子の偏光選択層）の保護機能

を有することが好ましい。保護機能の観点では、セルロールアセテートフィルムが好ましい。セルロースアセテートの酢化度は、55乃至61.5%（セルロールジアセテートまたはセルローストリアセテート）であることが好ましく、59乃至61%（セルローストリアセテート）であることがさらに好ましい。

セルローストリアセテートフィルムを透明支持体として使用する場合、セルローストリアセテートフィルムは、ハロゲン化炭化水素を溶媒として実質的に使用せずに製造されたフィルムであることが好ましい。従来のセルローストリアセテートフィルムは、一般にハロゲン化炭化水素（特に塩化メチレン）を溶媒として製造されていた。しかし、環境問題から、ハロゲン化炭化水素の使用は徐々に制限されている。一方、ハロゲン化炭化水素以外の有機溶媒では、セルローストリアセテートを溶解させることは困難であった。特開平9-95538号、同9-95544号および同9-95557号の各公報には、冷却によってセルローストリアセテートを通常の有機溶媒（炭素原子数3乃至12のエステル、エーテル、ケトンまたはアルコール）に溶解する方法が開示されている。この方法を用いることで、ハロゲン化炭化水素を溶媒として実質的に使用せずに製造されたセルローストリアセテートフィルムを製造することができる。この「実質的に使用せずに」とは、溶媒中のハロゲン化炭化水素の量が、5質量%以下（好ましくは1質量%以下）であることを意味する。また、製造されたセルローストリアセテートフィルムから、ハロゲン化炭化水素が全く検出されないことが好ましい。

透明支持体の厚みは、10乃至500 μm が好ましく、40乃至200 μm がさらに好ましい。

透明支持体に表面処理（例、化学処理、機械処理、コロナ処理、グロー放電処理）を行ってもよい。化学処理としては、ケン化処理が代表的である。

透明支持体と、偏光選択層のような隣接層とを密着性させるため、透明支持体に下塗り層を設けることができる。セルローストリアセテートフィルムを透明支持体として用いる場合は、下塗り層を、ゼラチン、ポリ（メタ）アクリレート、ポリ（メタ）アクリル酸エステル、ポリ（メタ）アクリルアミド、ポリスチレン、ポリブタジエンあるいはこれらの共重合体から形成することができる。

(光学的等方性連続相)

光散乱型偏光素子は、所定の偏光を選択的に透過し、他の偏光を選択的に反射または散乱する偏光選択層を有する。上記「所定の偏光」と「他の偏光」とは、一般に偏光面が互いに直交する。光散乱型偏光素子の偏光選択層は、光学的等方性連続相と光学異方性不連続相とからなる。

光学的等方性連続相は偏光選択層の5乃至95質量%であることが好ましく、20乃至90質量%であることがさらに好ましく、50乃至80質量%であることが最も好ましい。

光学的等方性連続相の「光学的等方性」とは、具体的には、光学的異方性が0.05未満であることを意味する（光学的異方性は、後述する光学的異方性不連続相について定義する）。

光学的等方性連続相は、ポリマーマトリックスとして形成することができる。使用するポリマーは、偏光選択層の形成段階（例えば、層の塗布液の状態）からポリマーであってもよいし、偏光選択層の形成段階ではモノマーであって、その後、重合によりポリマーを形成してもよい。

ポリマーとしては、光学的等方性が高いポリマーを用いる。ただし、固有複屈折が比較的大きいとされるポリマー（例、ポリカーボネート、ポリスチレン）であっても、添加剤により光学的等方性にすることで光学的等方性連続相に使用することもできる。

なお、光散乱型偏光素子へ入射する光に対する反射率を低下させることにより、バックライト光の利用効率を向上させることができる。そのためには、光学的等方性連続相を構成するポリマーマトリックスの平均屈折率（ n ）は1.70以下であることが好ましく、1.6以下であることがさらに好ましく、1.55以下であることが最も好ましい。ここで、平均屈折率（ n ）は下記式で表される。

$$n = (n_x + n_y + n_z) / 3$$

式中、 n_x は、面内の遅相軸方向の屈折率であり； n_y は、面内の進相軸方向の屈折率であり；そして、 n_z は、厚み方向の屈折率である。

光学的等方性連続相に使用するポリマーの例には、タンパク質（例、ゼラチン、カゼイン）、多糖類（例、アガロース、セルロース、プルラン、カラギーナン

、ポリガラクトロン酸、アルギン酸)、セルロースエーテル、セルロースエステル(例、セルロースアセテート、セルロースジアセテート、セルローストリアセテート、セルロースプロピオネート、セルロースブチレート、セルロースアセテートプロピオネート、セルロースニトレート)、ポリオレフィン(例、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリメチルペンテン)、ポリオレフィン誘導体(例、ポリ塩化ビニル、ポリビニルアルコール、変性ポリビニルアルコール、ノルボルネン樹脂)、ポリスチレン(例、シンジオタクチックポリスチレン)、ポリエステル(ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリカーボネート、ポリ-1,4-シクロヘキサンジメチレンテレフタレート、ポリエチレン-1,2-ジフェノキシエタン-4,4'-ジカルボキシレート、ポリブチレンテレフタレート)、ポリアミド、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリアリレート、ポリエーテルイミド、ポリエーテルケトン、ポリアクリル酸エステルおよびポリメタクリル酸エステル(例、メチルメタクリレート)が含まれる。

二種類以上のポリマーを混合して用いてもよい。市販のポリマー(例、ゼオネックス、日本ゼオン(株)製;ARTON、JSR(株)製;フジタック(富士写真フイルム(株)製)を使用することもできる。

光学的等方性連続相のポリマーを形成するためのモノマーは、熱または電離放射線照射により重合することが好ましい。モノマーの重合性基の例には、エチレン性不飽和二重結合、イソシアナート基、エポキシ基、アジリジン基、オキサゾリン基、アルデヒド基、カルボニル基、ヒドラジン基、カルボキシル基、メチロール基、活性メチレン基、ビニルスルホ基、酸無水結合($-CO-O-CO-$)、シアノアクリレート基、メラミン、エーテル化メチロール、エステル結合、ウレタン結合および金属アルコキシド(テトラメトキシシラン)構造が含まれる。エチレン性不飽和二重結合が好ましい。二個以上のエチレン性不飽和重合性基を有するモノマーを用いて、架橋構造を有するポリマーを形成することが特に好ましい。

二個以上のエチレン性不飽和結合を有するモノマーの例には、多価アルコールと(メタ)アクリル酸とのエステル(例、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、1,4-ジクロヘキサジアカリレート、ペンタエリスリトールテトラ

(メタ) アクリレート)、ペンタエリスリトールトリ (メタ) アクリレート、トリメチロールプロパントリ (メタ) アクリレート、トリメチロールエタントリ (メタ) アクリレート、ジペンタエリスリトールテトラ (メタ) アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ (メタ) アクリレート、ペンタエリスリトールヘキサ (メタ) アクリレート、1, 3, 5-シクロヘキサントリオールトリアクリレート、ポリウレタンポリアクリレート、ポリエステルポリアクリレート)、ビニルベンゼンおよびその誘導体 (例、1, 4-ジビニルベンゼン、4-ビニル安息香酸-2-アクリロイルエチルエステル、1, 4-ジビニルシクロヘキサノン)、ビニルスルホン (例、ジビニルスルホン)、アクリルアミド (例、メチレンビスアクリルアミド) およびメタクリルアミドが含まれる。

なお、光学的異方性不連続相の光学的異方性を延伸により発現 (液晶性化合物を配向) させる場合は、光学的等方性連続相のポリマーのガラス転移温度を低下させる化合物 (可塑剤) を、連続相に添加することが好ましい。可塑剤の例には、カルボン酸エステル (例、ジブチルフタレート)、リン酸エステル (例、トリフェニルホスフェート) および多価アルコール (例、グリセリン) が含まれる。連続相に水溶性のポリマーを用いる場合は、グリセリンを添加することが特に好ましい。

(光学的異方性不連続相)

光学的異方性不連続相は偏光選択層の3質量%以上であることが好ましく、4質量%以上であることがより好ましく、5質量%以上であることがさらに好ましく、10質量%以上であることがさらにまた好ましく、20質量%以上であることが最も好ましい。光学的異方性不連続相は偏光選択層の95質量%以下であることが好ましく、80質量%以下であることがより好ましく、60質量%以下であることがさらに好ましく、50質量%以下であることがさらにまた好ましく、40質量%以下であることが最も好ましい。

光学的異方性不連続相の「光学的異方性」とは、具体的には、光学的異方性が0.05以上であることを意味する。光学的異方性は、偏光選択層の全光線透過率が最大となる偏光の偏光面を含む軸方向の屈折率 (n_1) と全光線透過率が最

小となる偏光の偏光面を含む軸方向の屈折率 (n_2) との差の絶対値である複屈折 ($|n_1 - n_2|$) に相当する。光学的異方性は、0.05乃至1.00であることが好ましく、0.10乃至1.00であることがさらに好ましく、0.15乃至1.00であることが最も好ましい。

光学フィルムが、光散乱型偏光素子として機能するためには、光学的異方性不連続相の二つの屈折率 (n_1 および n_2) の一方が、光学的等方性連続相の屈折率と実質的に等しい (具体的には、差が0.05未満の) 値となることが必要である。屈折率の差は、0.01未満であることが好ましく、0.001未満であることがさらに好ましい。連続相と不連続相の屈折率が実質的に等しい値となる方向が、偏光選択層の透過軸に相当する。

光学的異方性不連続相は、粒子または液滴の状態で、光学的等方性連続相中に分散している。粒子または液滴の平均粒径 (粒子または液滴の平面領域をほぼ同面積の円で近似した近似円形の平均径) は、0.01乃至10 μm であることが好ましく、0.05乃至5 μm であることがさらに好ましく、0.05乃至1 μm であることが最も好ましい。

粒子または液滴の形状については、特に制限はない。実質的に球状 (平均アスペクト比が2以下) であっても、表面積が大きな不定形であってもよい。

光学的異方性不連続相は、光学的異方性物質を用いて形成する。光学的異方性は、偏光選択層の形成後に、一定方向からの光照射または一定方向への延伸により光学的異方性物質に発現 (配向) させることが好ましい。

光学的異方性物質としては、光配向性化合物 (光反応性化合物または光異性化合物)、液晶性化合物あるいは光配向性化合物と液晶性化合物との混合物が好ましく用いられる。光配向性化合物および光配向性化合物と液晶性化合物との混合物は、一定方向からの光照射により光学的異方性を発現させることができる。液晶性化合物は、一定方向への延伸により光学的異方性を発現させることができる。なお、液晶性化合物自身が光配向性を有して光の方向に自発的に並ぶ (液晶性化合物が後述する光異性化基あるいは光反応性基を有する) 場合は、液晶性化合物のみでも一定方向からの光照射により光学的異方性を発現させることができる。

光配向性化合物（光反応性化合物または光異性化化合物）は、ポリマー、すなわち光反応性ポリマーまたは光異性化ポリマーであることが好ましい。光反応性ポリマーは、さらに光二量化ポリマーと光分解ポリマーとに分類できる。

光二量化ポリマーは、光二量化型の感光性基を側鎖に有する。光二量化型感光性基は、光（好ましくは紫外線）の照射によって、二つの基の間に付加反応を起こして環化する官能基である。この付加反応により、ポリマーが二量化する。光二量化反応については、永松乾「感光性高分子」（講談社、1977）に記載がある。

光二量化型感光性基は、（a）カルボニル基または（b）エチレン不飽和結合と（c）芳香族基または（d）複素環基とを有することが好ましい。（a）カルボニル基と（b）エチレン不飽和結合の双方を有することが好ましい。また、（d）複素環基よりも（c）芳香族基の方が好ましい。従って、光二量化型感光性基は、（a）カルボニル基、（b）エチレン不飽和結合および（c）芳香族基を有する官能基であることが好ましい。

（a）カルボニル基は、アシル基、アシルオキシ基またはアルコキシカルボニル基に含まれていることが好ましい。

（b）エチレン性不飽和結合は、シス型よりもトランス型の方が好ましい。複数のエチレン不飽和結合が含まれる場合、それらは共役していることが好ましい。

（a）カルボニル基、（b）エチレン不飽和結合および（c）芳香族基を有する官能基では、主鎖－（a）－（b）－（c）の順序で結合していることが好ましい。上記（a）、（b）および（c）を有する官能基の例には、シンナモイルおよびフェニルマレイミドが含まれる。シンナモイル基を有する化合物については、Jpn. J. Appl. Phys., 31, P. 2155(1992)に記載がある。

光二量化ポリマーの主鎖と側鎖とはエステル結合で結合し、（a）カルボニル基はエステル結合に含まれていることが好ましい。

（b）エチレン不飽和結合、（c）芳香族基および（d）複素環基は、置換基を有していてもよい。置換基の例には、アルキル基（例、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ヘキシル）、アルコキシ基（例、メトキシ、エトキシ、プロポキ

シ、ブトキシ)、アルケニル基(例、アリル)、アルケニルオキシ基(例、アリルオキシ)、アリール基(例、フェニル)、アリールオキシ基(例、フェノキシ)、シアノ、アルコキシカルボニル基(例、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基)、ヒドロキシ、アルキル置換アミノ基(例、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ)およびニトロが含まれる。置換基としては、炭素原子数が1乃至6のアルキル基、炭素原子数が1乃至6のアルコキシ基、シアノ基、炭素原子数が1乃至6のアルコキシカルボニル基が好ましい。

光二量化型感光性基を側鎖に有する光二量化ポリマーは、様々な方法で合成できる。

例えば、感光性基と重合性基とを有する化合物(モノマー)を重合させることにより、ポリマーを合成することができる。重合性基としては、アクリロイル基またはメタクリロイル基が好ましい。(メタ)アクリロイル基は、ラジカル重合反応によって、容易にポリマーを合成できる。また、ヒドロキシ、カルボキシル、アミノあるいはシアネートのような重合性基の縮重合反応によるポリエステル、ポリアミド、ポリイミドあるいはポリウレタンであってもよい。これらの縮重合の場合は、モノマー中に少なくとも二つの重合性基が必要である。

また、感光性基を有する化合物と、ポリマーとを反応させて、感光性基を有するポリマーを得ることもできる。感光性基を有する化合物と反応させるポリマーとしては、ポリビニルアルコールおよびポリ(メタ)アクリル酸が好ましい。ポリマー(主鎖)と化合物(側鎖)との結合は、エーテル結合、エステル結合またはアミド結合であることが好ましい。

代表的な光二量化ポリマーは、ポリビニルシンナメートである。

光二量化ポリマーを用いる代わりに、感光性基を有する化合物をポリマー(バインダー)中に分散して用いてもよい。バインダーとして用いるポリマーは、(メタ)アクリル系ポリマー、ポリエステルまたはポリウレタンであることが好ましい。感光性基を有する化合物をバインダー中に分散してから、重合開始剤を用いて重合させてもよい。

光分解ポリマーの例には、ポリイミドが含まれる。光分解型ポリイミドについては、特開平5-34699号、同6-289399号、同8-122792号

の各公報および第22回液晶討論会講演予稿集、1672頁A17(1996)に記載がある。光分解ポリマーよりも光二量化ポリマーの方が好ましい。

光異性化化合物は、一般にフォトクロミック化合物として知られている。光異性化化合物は、光の作用で化学構造に変化が生じ、それにより光に対する挙動（例えば色調）も変化する化合物である。一般に、それらの変化は可逆的である。

光異性化化合物には、アゾベンゼン化合物 (K. Ichimura et al., *Langmuir*, vol. 4, page 1214 (1988); K. Aoki et al., *Langmuir*, vol. 8, page 1007 (1992); Y. Suzuki et al., *Langmuir*, vol. 8, page 2601 (1992); K. Ichimura et al., *Appl. Phys. Lett.*, vol. 63, No. 4, page 449 (1993); N. Ishizuki, *Langmuir*, vol. 9, page 3298 (1993); N. Ishizuki, *Langmuir*, vol. 9, page 857 (1993))、カルコン化合物 (*Nature*, 381, P.212(1998))、クマリン化合物 (SID' 98. Digest, P. 734(1998))、ヒドラゾノーβ-ケトエステル化合物 (S. Yamamura et al., *Liquid Crystals*, vol. 13, No. 2, page 189 (1993))、スチルベン化合物 (市村國宏他、高分子論文集、第47巻、10号、771頁(1990)) およびスピロピラン化合物 (K. Ichimura et al., *Chemistry Letters*, page 1063 (1992); K. Ichimura et al., *Thin Solid Films*, vol. 235, page 101 (1993)) が含まれる。

C=C、C=NまたはN=Nからなる二重結合構造を含む光異性化化合物が、特に好ましい。二重結合構造を有するフォトクロミック化合物は、下記(1)および(2)の必須要素と、下記(3)～(5)の任意要素からなる。

- (1) C=C、C=NまたはN=Nからなる二重結合構造
- (2) 上記(1)の結合の両側に(直結しなくてもよく)存在する環状構造
- (3) 任意の(1)と(2)との間の連結基
- (4) 任意の(1)の炭素原子の置換基
- (5) 任意の(2)の環状構造の置換基

上記(1)の二重結合構造は、シス型よりもトランス型が好ましい。二重結合構造は、分子内に二つ以上存在していてもよい。複数の二重結合構造は、共役の関係にあることが好ましい。

上記(2)の環状構造の例には、ベンゼン環、ナフタレン環および含窒素複素

環（例、ピリジニウム環、ベンゾピリジニウム環）が含まれる。含窒素複素環の場合、環を構成する（窒素原子ではなく）炭素原子が（１）の二重結合構造の炭素原子または窒素原子と結合することが好ましい。ベンゼン環が特に好ましい。

上記（３）の連結基の例には、 $-NH-$ および $-CO-$ が含まれる。ただし、（３）の連結基がなく、（１）と（２）とが直結していることが好ましい。

上記（４）の置換基の例には、アリール基（例、フェニル）およびシアノが含まれる。ただし、（４）の置換基がなく、二重結合構造に含まれる炭素原子が、（２）との結合以外は無置換（ $-CH=CH-$ または $-CH=N-$ ）であることが好ましい。

上記（５）の置換基の例には、アルコキシ基（例、メトキシ、ヘキシルオキシ）、シアノ、アルキル基（例、ブチル、ヘキシル）およびアルキルアミノ基（例、ジメチルアミノ）を挙げることができる。（２）の環状構造がベンゼン環の場合、パラ位に置換基が結合することが好ましい。なお、後述するように、フォトクロミック化合物をポリマーに化学的結合させて使用する場合は、ポリマーに化学的結合させるための官能基を、（５）の置換基として光異性化化合物に導入する。

光異性化化合物は、ポリマーに化学的に結合させて用いることが好ましい。使用するポリマーは、親水性ポリマー（例、ゼラチン、ポリビニルアルコール）であることが好ましい。ポリビニルアルコールが特に好ましく用いられる。

光異性化化合物とポリマーとの反応は、ポリマーの種類（特に官能基の種類）に応じて決定する。ポリビニルアルコールのような水酸基を有するポリマーの場合は、酸ハライドと水酸基との反応を利用して、光異性化化合物をポリマーと結合させることができる。具体的には、ハロゲン化アシル基（ $-COX$ 、 X はハロゲン）を、光異性化化合物に置換基として導入し、ハロゲン化アシル基とポリマーの水酸基との反応（ $Ph-COX + HO-P1 \rightarrow Ph-CO-O-P1 + HX$ 、 Ph は光異性化化合物、 $P1$ はポリマーの主鎖）により化学的に結合させる。

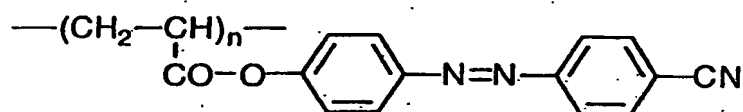
光配向性化合物（光反応性化合物または光異性化化合物）は、光配向性官能基として、アゾベンゼン構造、スチルベン構造、シンナモイル基、カルコン構造、クマリン構造またはポリイミド構造を有することが好ましく、アゾベンゼン構造

、スチルベン構造、シンナモイル基、カルコン構造またはクマリン構造を有することがさらに好ましく、シンナモイル構造、カルコン構造またはクマリン構造を有することが特に好ましい。

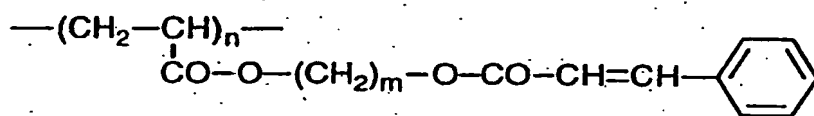
光配向性化合物と液晶性化合物とを併用する場合は、光学的異方性不連続相に、光配向性化合物が0.05乃至10質量%含まれることが好ましく、0.1乃至5質量%含まれることがさらに好ましい。

以下に光配向性化合物の例を、ポリマーの繰り返し単位として示す。ポリマーとしては、他の繰り返し単位を含むコポリマーを用いてもよい。

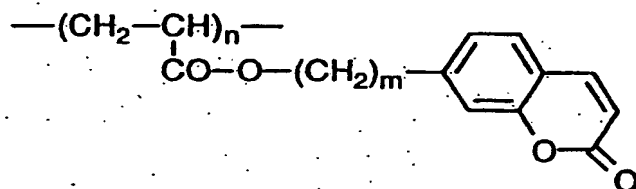
P A - 1



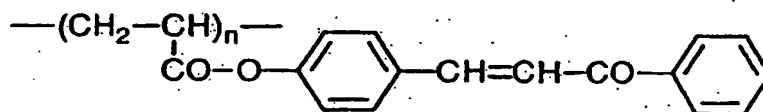
P A - 2



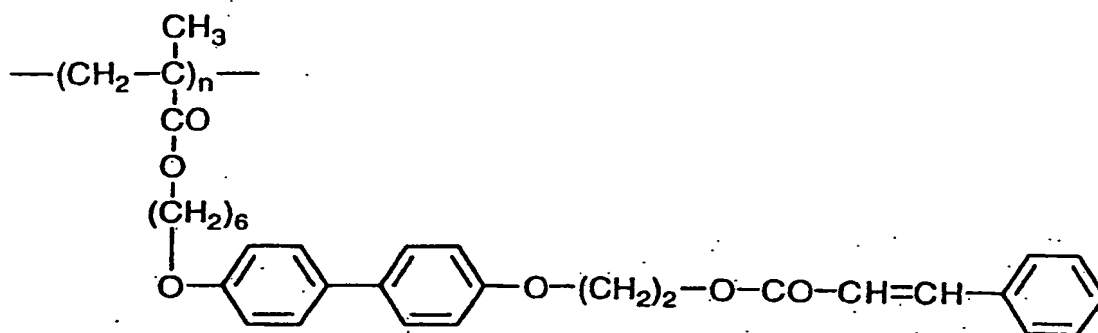
P A - 3



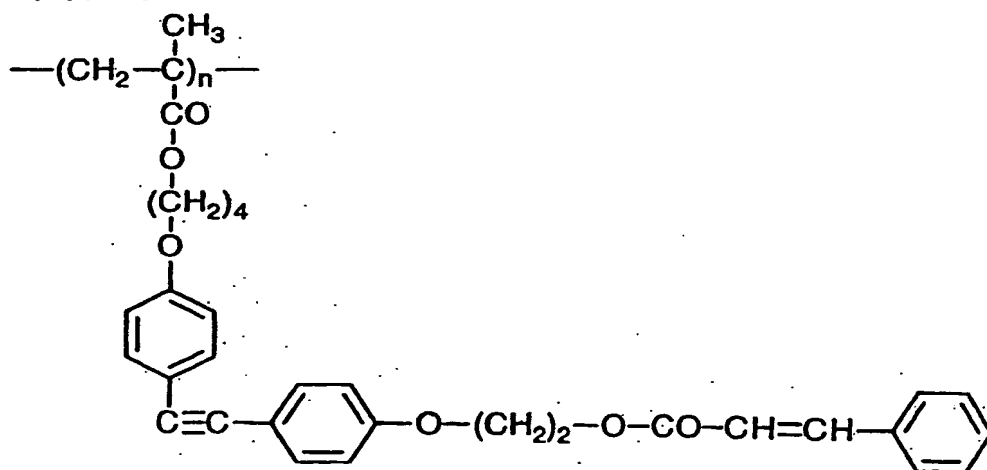
P A - 4



P A - 5



P A - 6



液晶性化合物は、 π 共役が3個以上結合した化合物であることが好ましい。光学的異方性を満足するためには、常光屈折率と異常光屈折率との差が大きな液晶性化合物を用いることが好ましい。室温でネマチック相もしくはスメクティック相を示す液晶性化合物が好ましい。棒状液晶性化合物を用いることが特に好ましい。

棒状液晶性化合物としては、アゾメチン類、アゾキシ類、シアノビフェニル類、シアノフェニルエステル類、安息香酸エステル類、シクロヘキサンカルボン酸フェニルエステル類、シアノフェニルシクロヘキサン類、シアノ置換フェニルピリミジン類、アルコキシ置換フェニルピリミジン類、フェニルジオキサン類、トラン類およびアルケニルシクロヘキシルベンゾニトリル類が好ましい。なお、棒状液晶性化合物には、金属錯体も含まれる。

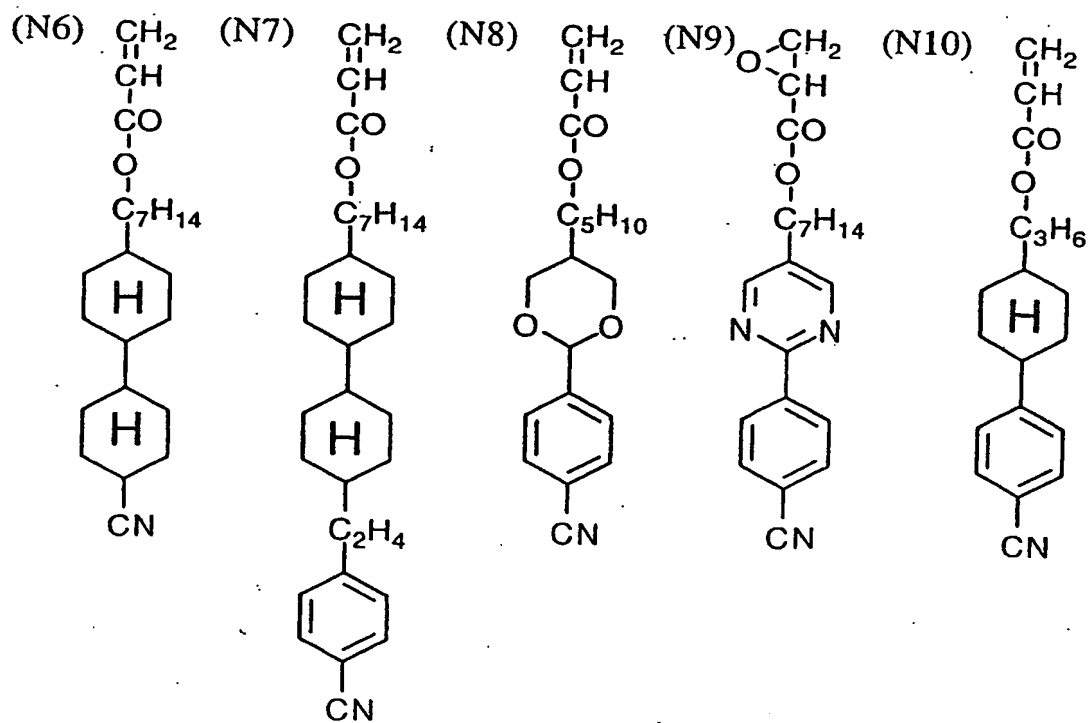
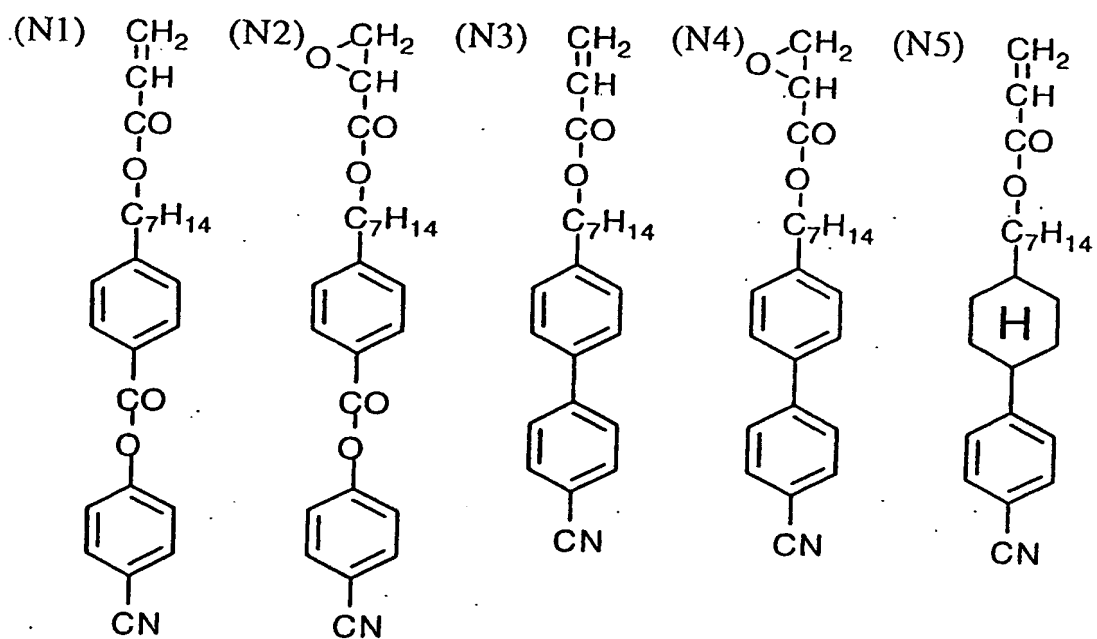
棒状液晶性化合物については、季刊化学総説第22巻液晶の化学（1994年）日本化学会編の第4章、第7章および第11章、および液晶デバイスハンドブック日本学術振興会第142委員会編の第3章に記載がある。

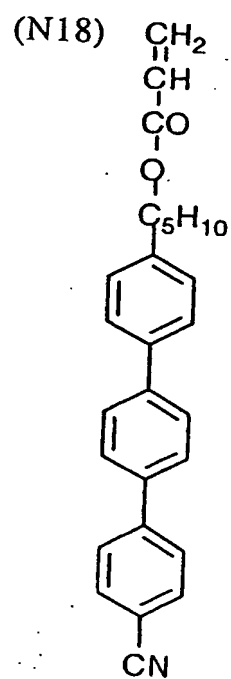
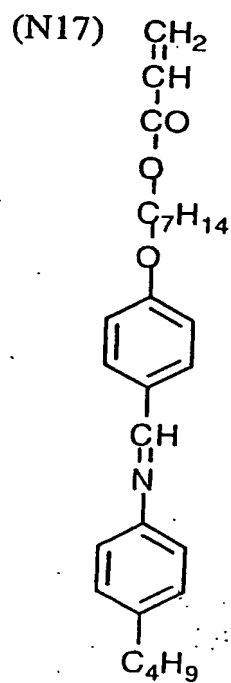
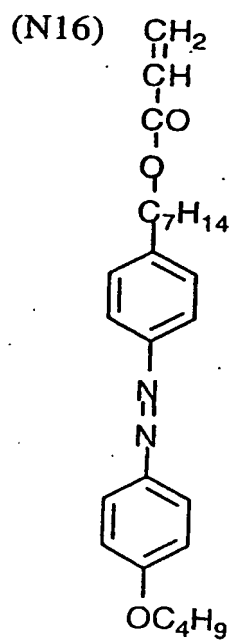
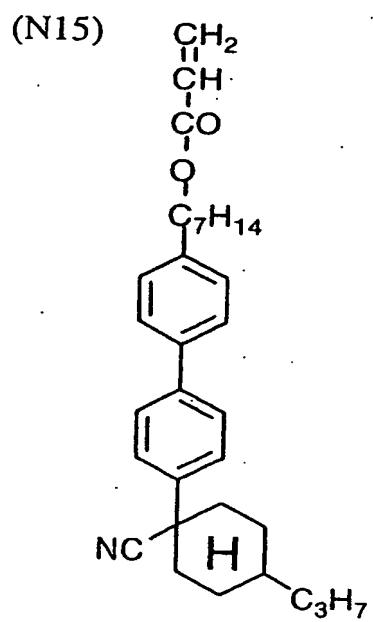
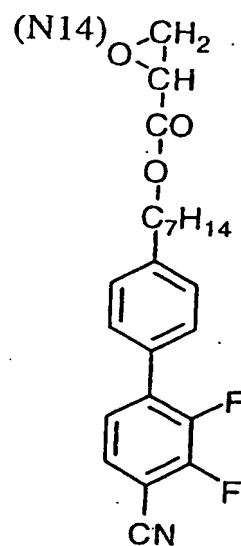
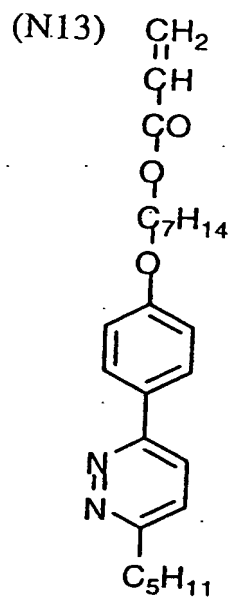
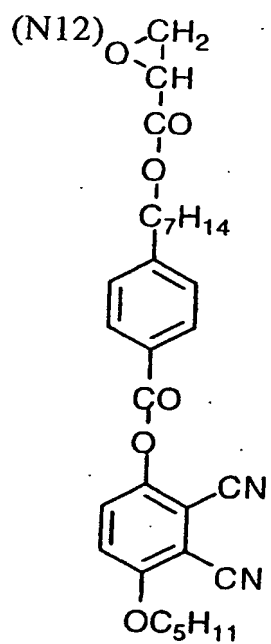
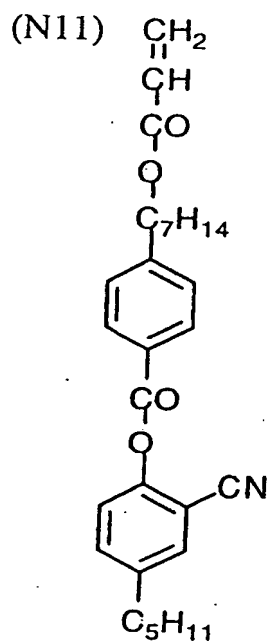
棒状液晶性化合物の固有複屈折は、0.001以上であることが好ましく、0.05以上であることがさらに好ましく、0.10以上であることが最も好ましい。固有複屈折は、1.00以下であることが好ましく、0.70以下であることがさらに好ましい。

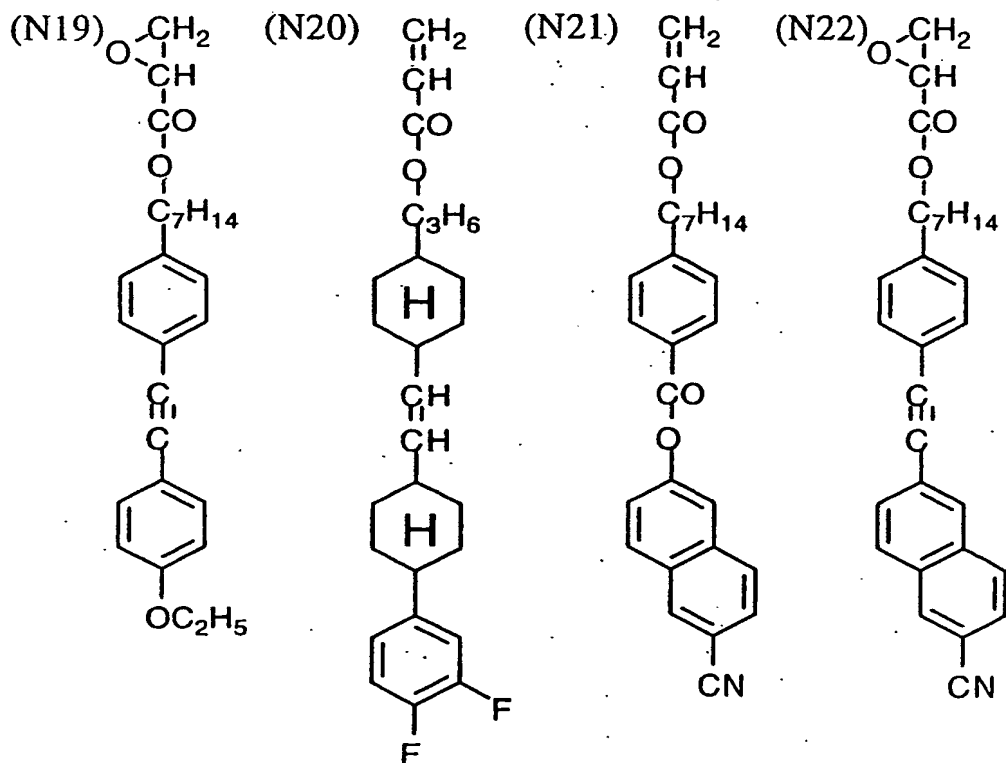
棒状液晶性化合物は、重合性基を有することが好ましい。重合性基としては、不飽和重合性基、エポキシ基またはアジリジニル基が好ましく、不飽和重合性基がさらに好ましく、エチレン性不飽和重合性基が最も好ましい。

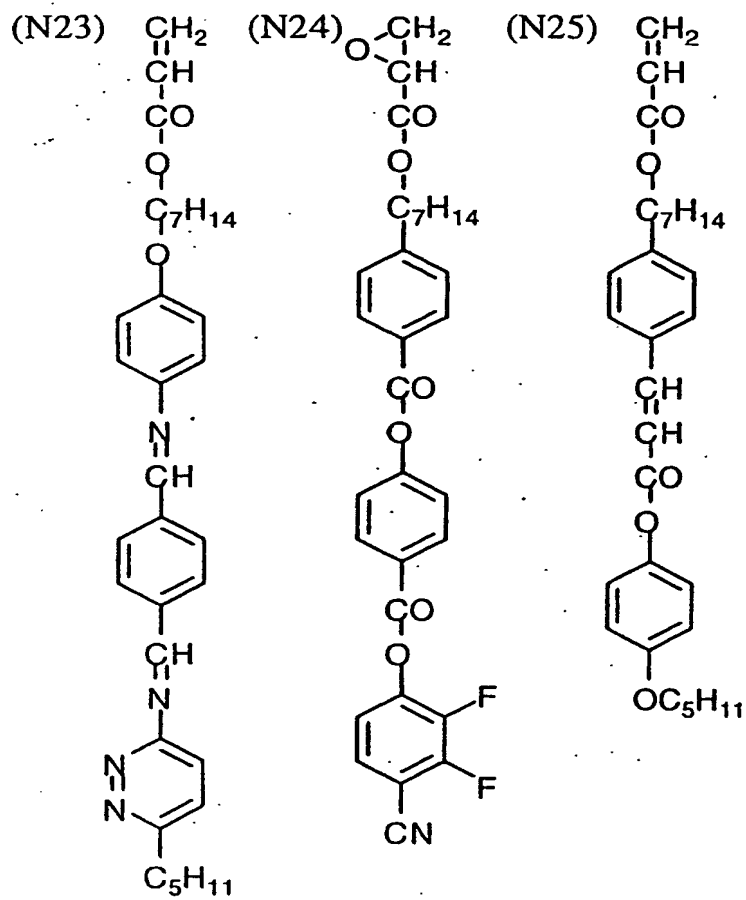
棒状液晶性化合物は、短軸方向に対してほぼ対称となる分子構造を有することが好ましい。そのためには、棒状分子構造の両端に重合性基を有することが好ましい。

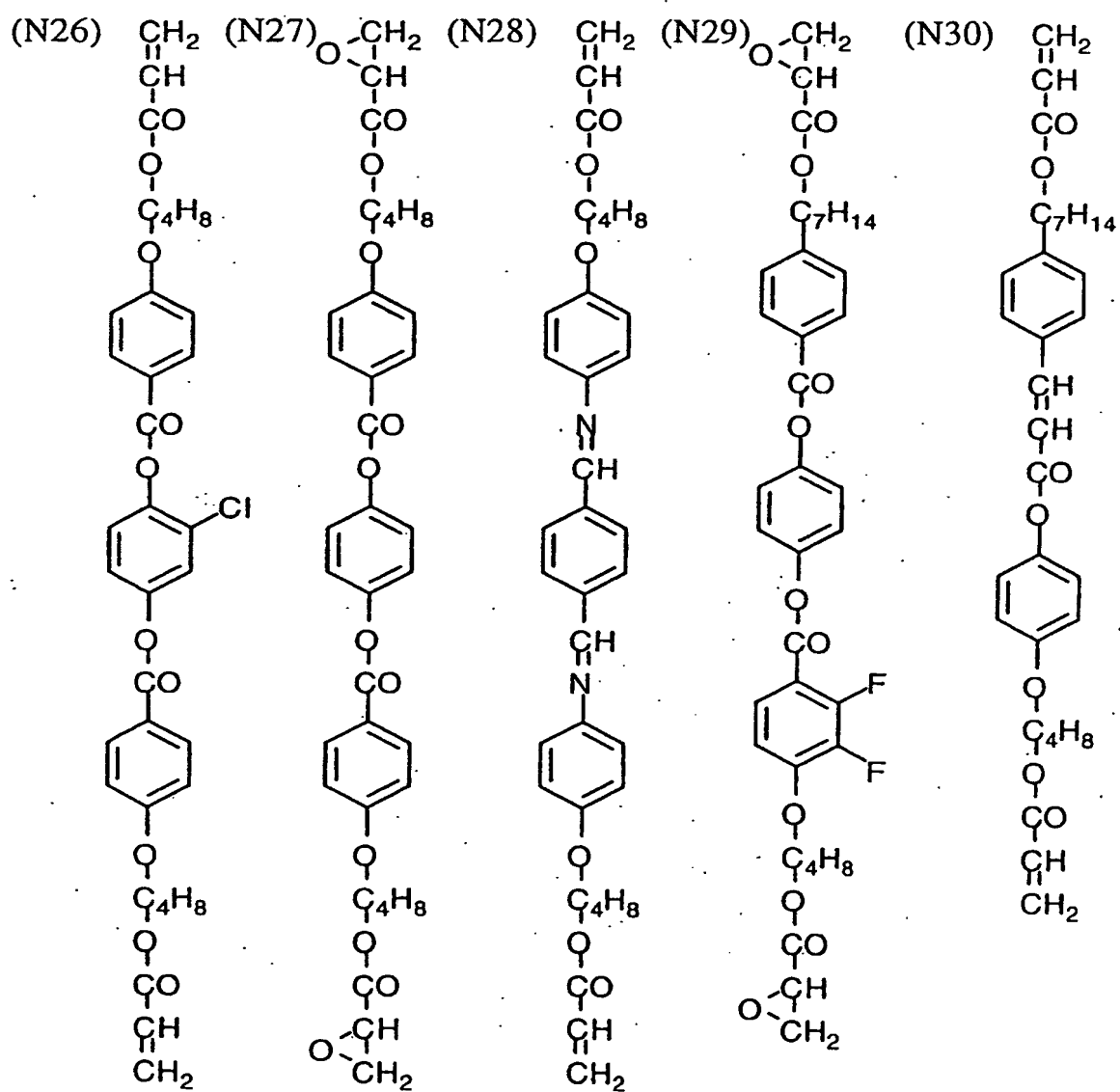
以下に、棒状液晶性化合物の例を示す。

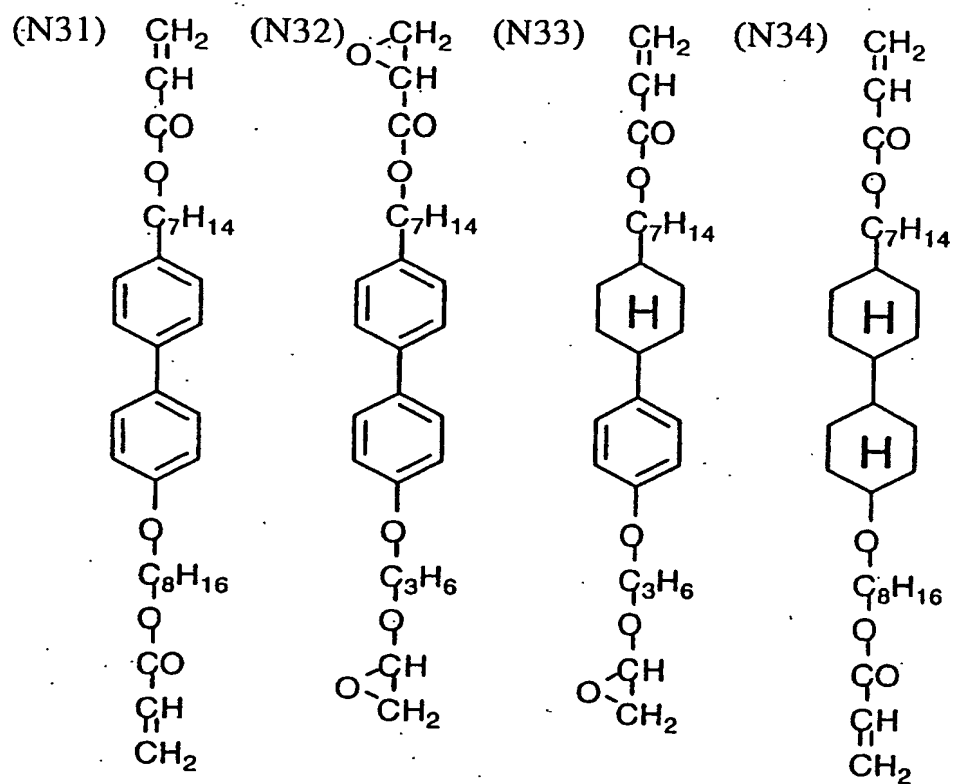


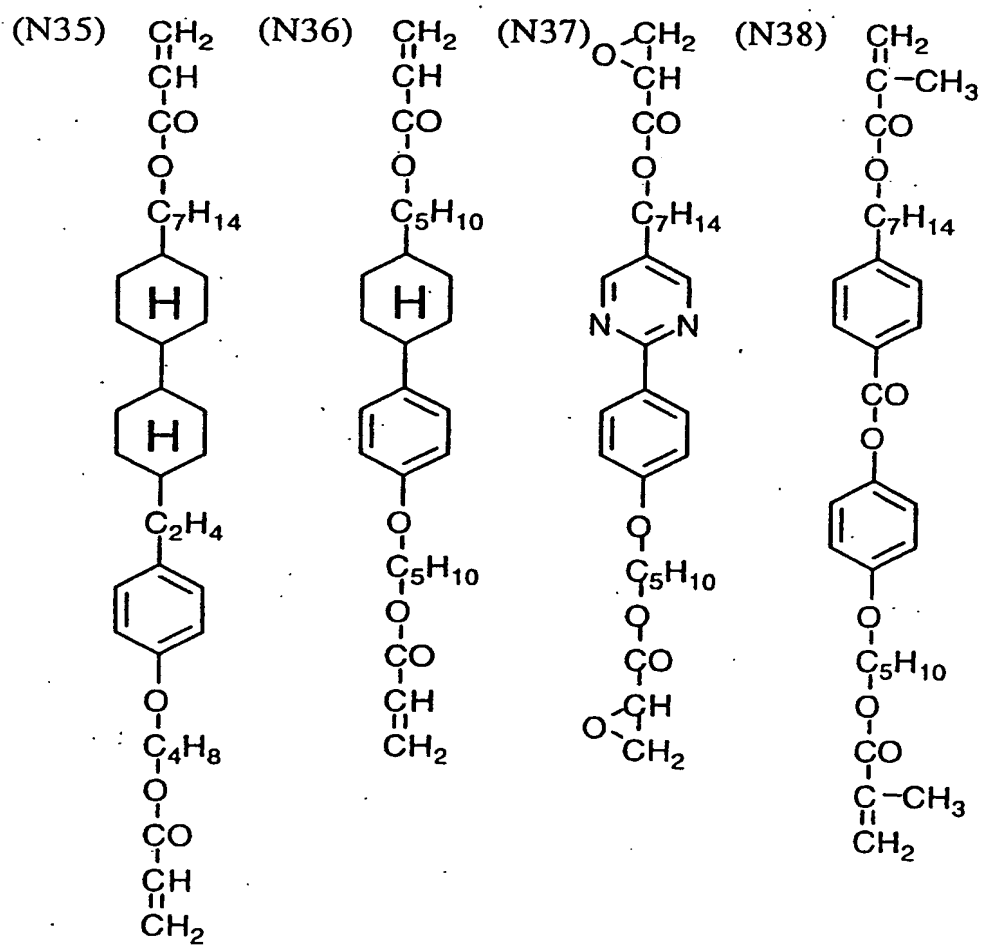


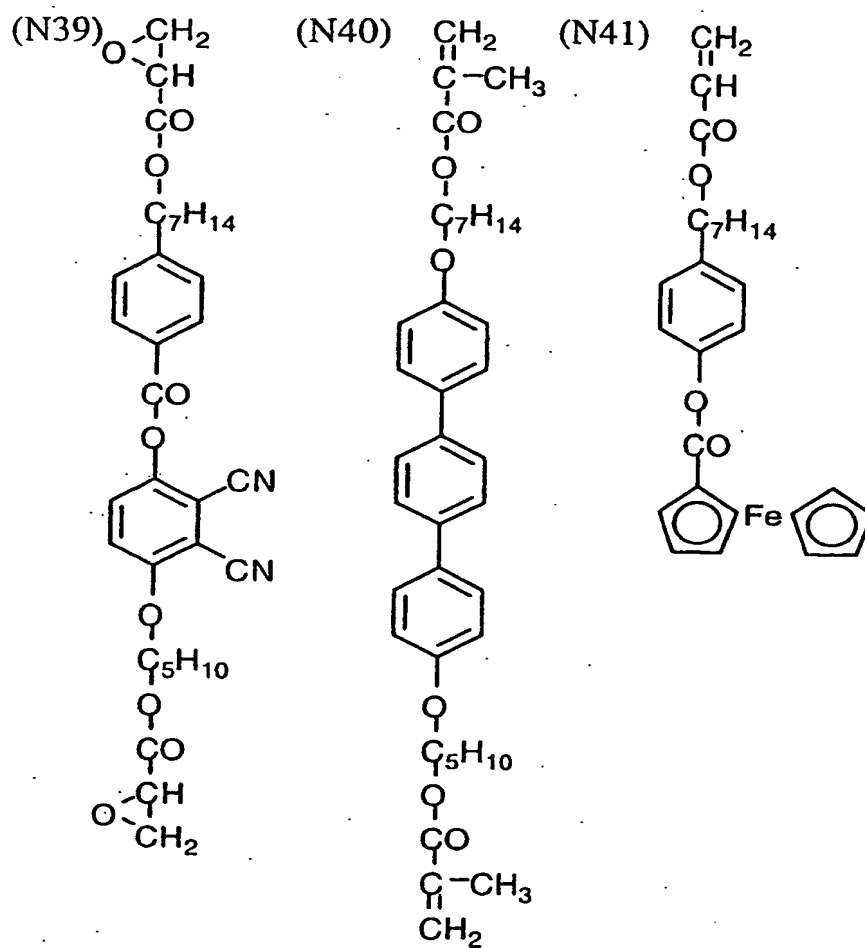


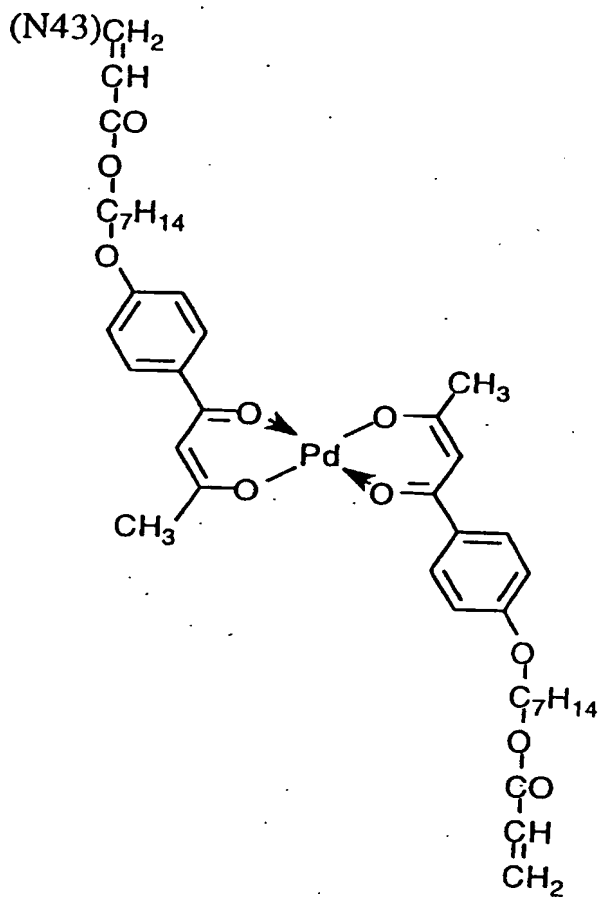
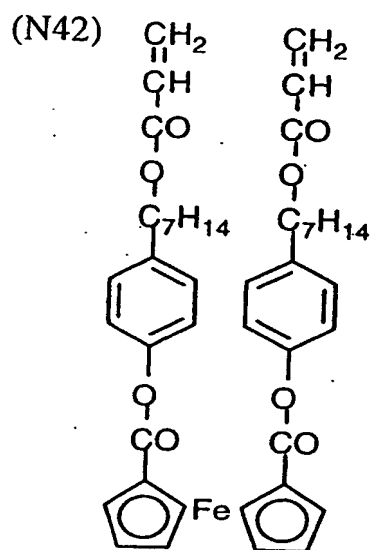


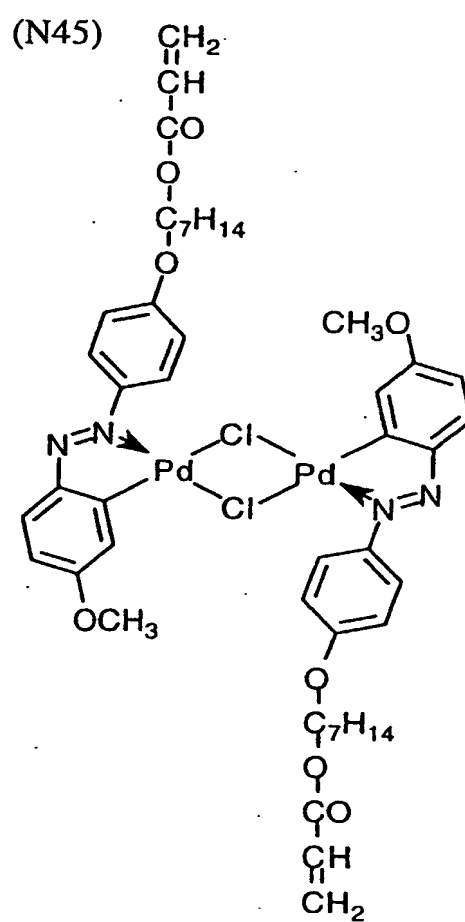
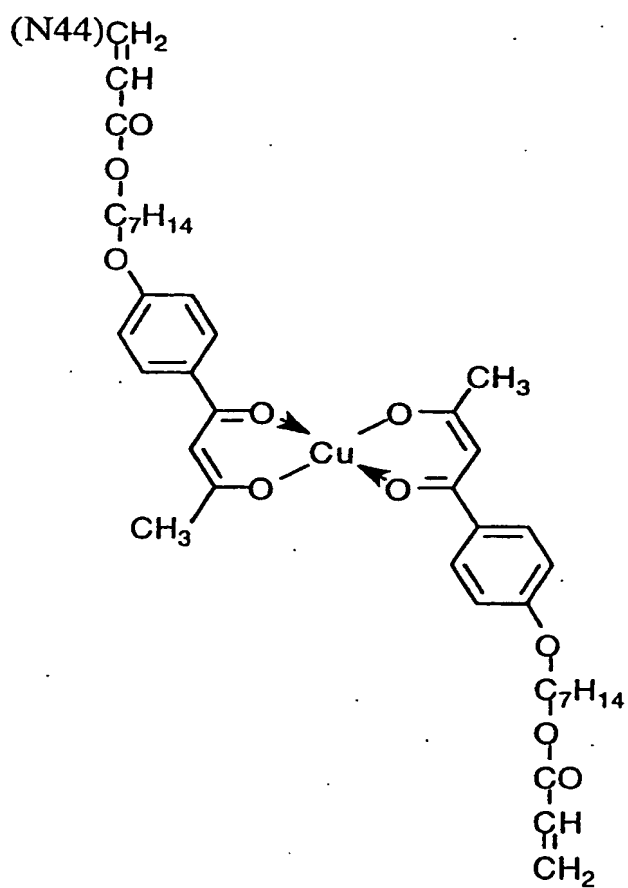


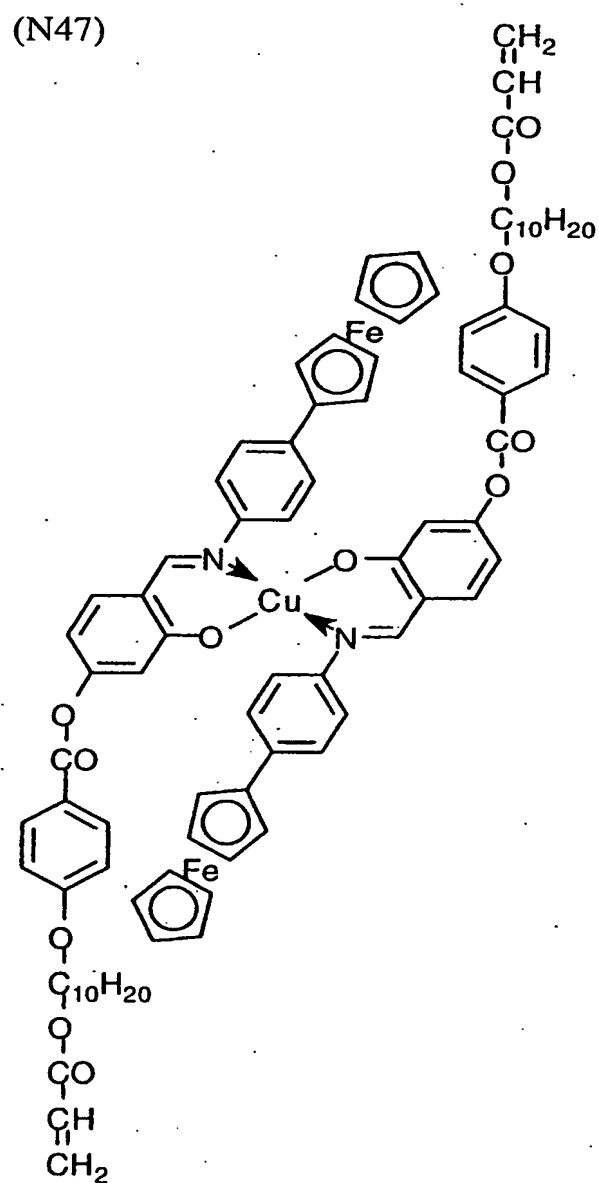
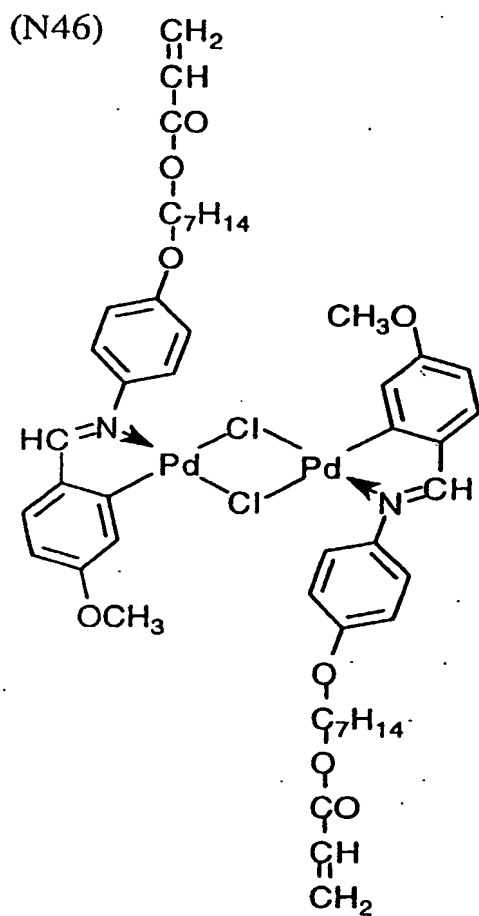












二種類以上の光反応性化合物、光異性化合物または液晶性化合物を併用できる。光学的異方性不連続相には、光反応性化合物、光異性化合物または液晶性化合物に加えて、可塑剤、ポリマーバインダーあるいは光重合開始剤を、必要に応じて添加することができる。可塑剤は、重合性を有することが好ましい。

(光散乱型偏光素子の偏光選択層形成)

光散乱型偏光素子の偏光選択層は、下記 (I) ~ (III) の順序で形成できる。

(I) 光学的等方性連続相の材料（一般にポリマー溶液）中に、光学的異方性不連続相の材料を、乳化または分散する。

(II) 得られた塗布液を支持体上に塗布および乾燥する。

(III) 一定方向から光を照射するか、一定方向に延伸することで、光学的異方性不連続相の光学的異方性を発現（液晶性化合物ならば配向）させる。

(I) の乳化または分散は、攪拌機（例、ホモジナイザー）あるいは混練機（例、サンドミル、コロイドミル）を用いることが好ましい。

界面活性剤を添加して、光学的異方性不連続相の粒径を微細かつ均一に調節してもよい。また、界面活性剤により光学的異方性不連続相の分散安定性を改善することもできる。界面活性剤は、光学的等方性連続相の溶媒が水である場合（光学的等方性連続相のポリマーが水溶性である場合）に特に有効である。ノニオン界面活性剤、アニオン界面活性剤、カチオン界面活性剤および両性界面活性剤のいずれも使用できる。

ノニオン界面活性剤としては、ポリオキシエチレン、ポリオキシプロピレン、ポリオキシブチレン、ポリグリシジルあるいはソルビタンを用いることができる。ノニオン界面活性剤の例には、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニールエーテル、ポリオキシエチレンーポリオキシプロピレングリコール、多価アルコール脂肪酸部分エステル、ポリオキシエチレン多価アルコール脂肪酸部分エステル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステルおよび脂肪酸ジエタノールアミド、トリエタノールアミン脂肪酸部分エステルが含まれる。

アニオン界面活性剤としては、カルボン酸塩、硫酸塩、スルホン酸塩あるいは

リン酸エステル塩を用いることができる。アニオン界面活性剤の例には、脂肪酸塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルナフタレンスルホン酸塩、アルキルスルホン酸塩、 α -オレフィンスルホン酸塩、ジアルキルスルフォコハク酸塩、 α -スルホン化脂肪酸塩、N-メチル-N-オレイルタウリン、石油スルホン酸塩、アルキル硫酸塩、硫酸化油脂、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル硫酸塩、ポリオキシエチレンスチレン化フェニルエーテル硫酸塩、アルキルリン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテルリン酸塩およびナフタレンスルホン酸塩ホルムアルデヒド縮合物が含まれる。

カチオン界面活性剤としては、アミン塩、4級アンモニウム塩あるいはピリジニウム塩を用いることができる。カチオン界面活性剤の例には、第一～第三脂肪アミン塩、テトラアルキルアンモニウム塩、トリアルキルベンジルアンモニウム塩、アルキルピリジウム塩およびアルキルイミダゾリウム塩が含まれる。

両性界面活性剤としては、カルボキシベタインまたはスルホベタインを用いることができる。両性界面活性剤の例には、N-トリアルキル-N-カルボキシメチルアンモニウムベタインおよびN-トリアルキル-N-スルフォアルキレンアンモニウムベタインが含まれる。

界面活性剤については、「界面活性剤の応用（幸書房、刈米孝夫著、昭和55年9月1日発行）」に記載がある。界面活性剤の使用量は、不連続相1 g当たり、0.001乃至1 gであることが好ましく、0.01乃至0.1 gであることがさらに好ましい。

(II) の塗布は、公知の塗布方法（例、ディップコート法、エアーナイフコート法、カーテンコート法、ローラーコート法、ワイヤーバーコート法、グラビアコート法、押し出しコート法、スピンのコート法、印刷コート法、スプレーコート法およびスライドコート法）により実施できる。連続塗布が可能である方法、すなわち、ディップコート法、カーテンコート法、押し出しコート法（米国特許2681294号明細書記載）、ローラーコート法およびスライドコート法が好ましい。

二以上の層（二以上の層から成る偏光選択層、あるいは偏光選択層と他の層

）とを同時に塗布してもよい。同時塗布の方法については、米国特許2761791号、同2941898号、同3508947号、同3526528号の各明細書および原崎勇次著、コーティング工学、253頁、朝倉書店（1973）に記載がある。偏光選択層中で、光学的異方性不連続相の粒径に厚み方向で分布をつける場合は、C型重層塗布法を採用することが好ましい。

形成する偏光選択層の厚さは、0.1 μm 以上であることが好ましく、1 μm 以上であることがより好ましく、3 μm 以上であることがさらに好ましく、10 μm 以上であることが最も好ましい。偏光選択層の厚さは、1000 μm 以下であることが好ましく、500 μm 以下であることがより好ましく、300 μm 以下であることがさらに好ましく、100 μm 以下であることがさらにまた好ましく、70 μm 以下であることが最も好ましい。

偏光選択層は、上記のように、任意の支持体（例えば、バンドまたはドラムのような無端支持体）の上に形成し、支持体から剥ぎ取ってから（III）の光照射または延伸を実施し、それを透明支持体にラミネートすることができる。また、透明支持体に塗布した後、そのまま（III）の光照射または延伸を実施して用いることもできる。また、任意の支持体の上に偏光選択層を形成し、（III）の光照射または延伸を実施して、それから透明支持体に転写してもよい。

（III）の光照射は、光として直線偏光を用いることが好ましい。また、なるべく単一方向から光を照射することも好ましい。単一方向とは、層の平面（光の方向を平面に投影した向き）において単一方向であることを意味し、平面に対して水平または垂直の方向も含む。

光の波長は、一般に190乃至1600 nmであり、320 nm以下（紫外線）であることが好ましい。具体的な波長は、光配向性化合物の光配向性官能基の種類に応じて決定する。

光源としては、水銀灯、キセノン灯、蛍光灯、メタルハライドランプ、ケミカルランプおよび不活性ガスレーザーが好ましい。光源から出射された紫外線は、偏光素子を利用して紫外線偏光とする。偏光素子は、プリズム系素子（例、グラントムソンプリズム）またはブリュースター角を利用した反射型素子であることが好ましい。なお、不活性ガスレーザーを光源とする紫外線は偏光となっている。

場合がある。その場合には、偏光素子は不要である。

非偏光を用いる場合は、斜めに光を照射する必要がある。非偏光の斜め照射による光学異方性の発現（配向）については、Polym. Mater. Sci. Eng., 66, P. 263 (1992)に記載がある。

露光量は、 1 mJ/cm^2 以上であることが好ましく、 10 mJ/cm^2 以上であることがより好ましく、 20 mJ/cm^2 以上であることがさらに好ましく、 40 mJ/cm^2 以上であることがさらにまた好ましく、 80 mJ/cm^2 以上であることが最も好ましい。露光量は、 10 J/cm^2 以下であることが好ましく、 2 J/cm^2 以下であることがより好ましく、 1 J/cm^2 以下であることがさらに好ましく、 500 mJ/cm^2 以下であることが最も好ましい。

露光強度は、 20 乃至 2000 mW/cm^2 であることが好ましく、 40 乃至 1000 mW/cm^2 であることがさらに好ましく、 80 乃至 500 mW/cm^2 であることが最も好ましい。短時間で光学的異方性を発現させるために、加熱しながら光を照射してもよい。

(III)の延伸は、光吸収型偏光素子の製造における高倍率（ 4 乃至 10 倍）の延伸処理は必要としない。生産性の観点から延伸倍率は 3.0 倍以下である。延伸倍率は、 2.0 倍以下が好ましく、 1.5 倍以下がより好ましく、 1.3 倍以下がさらに好ましく、 1.2 倍以下がさらにまた好ましく、 1.1 倍以下が最も好ましい。また、延伸効果の観点で、延伸倍率は、 1.01 倍以上であることが好ましい。

このような低い延伸倍率による方法は、他の方法に比べると簡便に大面積で配向させることができ、しかも他の方法に比べると不連続相の大きな複屈折が得られる。その結果として、光散乱型偏光素子の大きな面積にわたって均一かつ大きな散乱特性が得られる。

すなわち、低い延伸倍率による延伸方法によって、フィルム面に垂直な偏光面において、最大の全光線透過率が 75% 以上であり、最小の全光線透過率が 60% 未満であるとの優れた光学特性を有する光学フィルムを製造することができる。

(光吸収型偏光素子)

光吸収型偏光素子は、所定の偏光を選択的に透過し、他の偏光を選択的に吸収する偏光選択層を有する。上記「所定の偏光」と「他の偏光」とは、一般に偏光面が互いに直交する。

光吸収型偏光素子の偏光選択層は、一般にポリビニルアルコール系フィルムからなる光吸収型偏光素子が用いられている。ポリビニルアルコール系フィルムを延伸し、ヨウ素または二色性染料を吸着することにより光吸収型偏光素子の偏光選択層が得られる。光吸収型偏光素子の透過軸（偏光軸）は、フィルムの延伸方向に垂直な方向に相当する。

光吸収型偏光素子の偏光度は、99%以上であることが好ましい。偏光度は、下記式で定義される値である。

$$\text{偏光度} = 100 \times \{ (P - C) / (P + C) \}^{1/2}$$

式中、Pは透過軸を平行にした2枚の偏光素子を透過する光の透過率であり；そして、Cは透過軸を直交させた2枚の偏光素子を透過する光の透過率である。

光吸収型偏光素子は、市販されており、市販品を用いてもよい。

(偏光板)

光散乱型偏光素子と、光吸収型偏光素子とを積層して偏光板として用いる。光散乱型偏光素子の透過軸と光吸収型偏光素子の透過軸とは、実質的に平行になるように配置する。

偏光板は、直線偏光板として機能する。偏光板とλ/4板とを積層することで、積層体を円偏光板として機能させることもできる。円偏光板では、偏光板の透過軸とλ/4板の遅相軸との角度を、実質的に45°になるように配置する。円偏光板を液晶表示装置に組み込む場合、一般に、バックライト側からλ/4板、光散乱型偏光素子、光吸収型偏光素子の順序で配置する。

光散乱型偏光素子の偏光選択層側表面に、反射防止層を設けることもできる。反射防止層により表面反射が減少し、結果としてディスプレイの輝度を上昇させることができる。反射防止層としては、低屈折率層と高屈折率層の積層体（日本写真学会誌29、137頁（1966）記載）あるいは低屈折率層一層のみを設

けることができる。

偏光板と液晶表示装置の光学補償シートとを組み合わせることもできる。本発明の偏光板と光学補償フィルムとを組み合わせると、液晶表示装置の視野角を著しく拡大し、高い輝度の画像が得られる。透明支持支持体上にディスコティック液晶性化合物から形成した光学異方性層を有する光学補償シート（特許第2587398号公報記載）が好ましい。

光学補償シートの透明支持体は、偏光板の透明支持体（前述）とは異なり、光学的異方性を有することが好ましい。

特開平7-191217号公報に記載されているように、光学補償シートと偏光板と一体化することもできる。

（液晶表示装置）

偏光板は、液晶表示装置に組み込んで使用する。本発明は、液晶表示装置がツイストネマチック配向モードの液晶セル、ベンド配向モードの液晶セルまたは水平配向モードの液晶セルを有する場合に、特に効果がある。

透過型液晶表示装置では、液晶セルの両側（バックライト側と観察者側）に二枚の偏光板を使用する。本発明の偏光板をバックライト側の偏光板として使用すると、液晶表示装置の光の利用効率を改善できる。

ツイストネマチック（TN）配向モードの液晶セルは、最も普通に（特に、TFT液晶表示装置に）用いられている液晶セルであって、様々な文献に記載がある。

本発明の偏光板と光学異方性透明支持体上にディスコティック液晶性化合物から形成した光学異方性層を有する光学補償シートとを一体化した積層体を、ツイストネマチック配向モードの液晶表示装置に組み込む場合、ディスコティック液晶性化合物の円盤面の法線の光学異方性透明支持体面への正射影の平均方向と光学異方性透明支持体の面内遅相軸との角度が実質的に平行または実質的に垂直になるように、光学異方性層と光学異方性透明支持体とを配置する。また、光学異方性透明支持体の面内遅相軸と偏光板の面内透過軸とは、実質的に平行または実質的に垂直になるように、光学異方性透明支持体と偏光板とを配置する。

ベンド配向モードの液晶セルは、セル中央部の液晶分子がねじれ配向していてもよい。

ベンド配向液晶セルでは、液晶性化合物の屈折率異方性 Δn と、液晶セルの液晶層の厚み d との積($\Delta n \times d$)は、輝度と視野角を両立させるために、100乃至2000nmの範囲であることが好ましく、150乃至1700nmの範囲であることがさらに好ましく、500乃至1500nmの範囲であることが最も好ましい。

本発明の偏光板と光学異方性透明支持体上にディスコティック液晶性化合物から形成した光学異方性層を有する光学補償シートとを一体化した積層体を、ベンド配向モードの液晶表示装置に組み込む場合、ディスコティック液晶性化合物の円盤面の法線の光学異方性透明支持体面への正射影の平均方向と光学異方性透明支持体の面内遅相軸との角度が実質的に45°になるように、光学異方性層と光学異方性透明支持体とを配置する。また、光学異方性透明支持体の面内遅相軸と偏光板の面内透過軸とが実質的に平行または実質的に垂直になるように、透明支持体と偏光板とを配置する。

水平配向液晶セルでは、液晶性化合物の屈折率異方性 Δn と、液晶セルの液晶層の厚み d との積($\Delta n \times d$)は、輝度と視野角を両立させるために、100乃至2000nmの範囲であることが好ましく、100乃至1000nmの範囲であることがさらに好ましく、100乃至700nmの範囲であることが最も好ましい。

本発明の偏光板と光学異方性透明支持体上にディスコティック液晶性化合物から形成した光学異方性層を有する光学補償シートとを一体化した積層体を、水平配向モードの液晶表示装置に組み込む場合、ディスコティック液晶性化合物の円盤面の法線の光学異方性透明支持体面への正射影の平均方向と光学異方性透明支持体の面内遅相軸との角度が実質的に45°になるように、光学異方性層と光学異方性透明支持体とを配置する。また、光学異方性透明支持体の面内遅相軸と偏光板の面内透過軸とが実質的に平行または実質的に垂直になるように、光学異方性透明支持体と偏光板とを配置する。

液晶セルは、いずれも、ノーマリーホワイトモード(NWモード)またはノー

マリーブラックモード（NBモード）で用いることができる。
ことが好ましい。

〔実施例 1〕

（屈折率の測定）

偏光素子の製造後では屈折率の測定が難しいため、製造前に光学的等方性連続相と光学的異方性不連続相との屈折率を測定した。

ゼラチン（光学的等方性連続相のポリマーマトリックス）10質量部を水90質量部に加え、加熱しながら溶解した。得られた溶液を高屈折率ガラス上に塗布し、乾燥した。形成したゼラチン膜（光学的等方性相）の屈折率をナトリウムのD線においてアッペ屈折計で測定したところ、いずれの方向の屈折率も1.54であった。

光配向性ポリマー（PA-5、光二量化ポリマー）をジクロロメタンに溶解して30質量%溶液を調製した。溶液を高屈折率ガラス上に塗布し、乾燥した後、室温で波長365nmの直線偏光（200mW/cm²）を10秒間照射した。形成した光配向性ポリマーの被膜（光学的異方性相）の屈折率をアッペ屈折計で測定したところ、偏向方向の屈折率（n_e）は1.64、偏向方向と直交する方向の屈折率（n_o）は1.54であった。

（光散乱型偏光素子の作製）

ゼラチン10質量部を水90質量部に加え、加熱しながら溶解した。得られた溶液に、光配向性ポリマー（PA-5、光二量化ポリマー）の30質量%ジクロロメタン溶液2質量部を添加し、ホモジナイザーを用いて乳化した。

セルローストリアセテートフィルム（透明支持体）に、ゼラチン下塗り層を設けた。ゼラチン下塗り層の上に、得られた乳化液を塗布し、乾燥した。形成した厚さ30μmの被膜に、室温で波長365nmの直線偏光（200mW/cm²）を10秒間照射し、光散乱型偏光素子を作製した。

（偏光板の作製）

作製した光散乱型偏光素子と、市販の光吸収型偏光素子とを接着剤を介して積層し、偏光板を作製した。

偏光板を液晶表示装置用バックライトの上に配置した。光散乱型偏光素子の透過軸（光学的等方性連続相の屈折率と光学的異方性不連続相の屈折率とが実質的に等しくなる方向）と光吸収型偏光素子の透過軸とは、平行になるように配置した。その状態で透過率を測定したところ、45%であった。

[実施例2]

(屈折率の測定)

光配向性ポリマー（PA-1、光異性化ポリマー）をシクロヘキサノンに溶解して30質量%溶液を調製した。溶液を高屈折率ガラス上に塗布し、乾燥した後、室温で波長435nmの直線偏光（200mW/cm²）を10秒間照射した。形成した光配向性ポリマーの被膜（光学的異方性相）の屈折率をアッペ屈折計で測定したところ、偏向方向の屈折率（ n_e ）は1.54、偏向方向と直交する方向の屈折率（ n_o ）は1.62であった。

(光散乱型偏光素子の作製)

ゼラチン10質量部を水90質量部に加え、加熱しながら溶解した。得られた溶液に、光配向性ポリマー（PA-1、光異性化ポリマー）の30質量%シクロヘキサノン溶液2質量部を添加し、ホモジナイザーを用いて乳化した。

セルローストリアセートフィルム（透明支持体）に、ゼラチン下塗り層を設けた。ゼラチン下塗り層の上に、得られた乳化液を塗布し、乾燥した。形成した厚さ30μmの被膜に、室温で波長435nmの直線偏光（200mW/cm²）を10秒間照射し、光散乱型偏光素子を作製した。

(偏光板の作製)

作製した光散乱型偏光素子と、市販の光吸収型偏光素子とを接着剤を介して積層し、偏光板を作製した。

偏光板を液晶表示装置用バックライトの上に配置した。光散乱型偏光素子の透

過軸（光学的等方性連続相の屈折率と光学的異方性不連続相の屈折率とが実質的に等しくなる方向）と光吸収型偏光素子の透過軸とは、平行になるように配置した。その状態で透過率を測定したところ、44.5%であった。

[実施例3]

(屈折率の測定)

光配向性ポリマー（PA-5、光二量化ポリマー）10質量部および棒状液晶性化合物（N26）90質量部を混合した。混合物をジクロロメタンに溶解して、30質量%溶液を調製した。溶液を高屈折率ガラス上に塗布し、乾燥した後、室温で波長365nmの直線偏光（200mW/cm²）を10秒間照射した。さらに、波長310nmの非偏光（200mW/cm²）を10秒間照射して、棒状液晶性化合物を重合させて配向状態を固定した。形成した被膜（光学的異方性相）の屈折率をアッペ屈折計で測定したところ、偏向方向の屈折率（ n_e ）は1.66、偏向方向と直交する方向の屈折率（ n_o ）は1.54であった。

(光散乱型偏光素子の作製)

ゼラチン10質量部を水90質量部に加え、加熱しながら溶解した。得られた溶液に、光配向性ポリマー（PA-5、光二量化ポリマー）10質量部および棒状液晶性化合物（N26）90質量部からなる混合物の30質量%ジクロロメタン溶液2質量部を添加し、ホモジナイザーを用いて乳化した。

セルローストリアセテートフィルム（透明支持体）に、ゼラチン下塗り層を設けた。ゼラチン下塗り層の上に、得られた乳化液を塗布し、乾燥した。形成した厚さ30μmの被膜に、室温で波長365nmの直線偏光（200mW/cm²）を10秒間照射した。さらに、波長310nmの非偏光（200mW/cm²）を10秒間照射して、棒状液晶性化合物を重合させて配向状態を固定し、光散乱型偏光素子を作製した。

(偏光板の作製)

作製した光散乱型偏光素子と、市販の光吸収型偏光素子とを接着剤を介して積

層し、偏光板を作製した。

偏光板を液晶表示装置用バックライトの上に配置した。光散乱型偏光素子の透過軸（光学的等方性連続相の屈折率と光学的異方性不連続相の屈折率とが実質的に等しくなる方向）と光吸収型偏光素子の透過軸とは、平行になるように配置した。その状態で透過率を測定したところ、46%であった。

[実施例4]

(屈折率の測定)

光配向性ポリマー（PA-1、光異性化ポリマー）10質量部および棒状液晶性化合物（N26）90質量部をシクロヘキサノンに溶解して30質量%溶液を調製した。溶液を高屈折率ガラス上に塗布し、乾燥した後、室温で波長435nmの直線偏光（200mW/cm²）を10秒間照射した。偏光照射後、130℃で30分間加熱した。さらに、波長310nmの非偏光（200mW/cm²）を10秒間照射して、棒状液晶性化合物を重合させて配向状態を固定した。形成した被膜（光学的異方性不連続相）の屈折率をアッペ屈折計で測定したところ、偏向方向の屈折率（n_e）は1.54、偏向方向と直交する方向の屈折率（n_o）は1.65であった。

(光散乱型偏光素子の作製)

ゼラチン10質量部を水90質量部に加え、加熱しながら溶解した。得られた溶液に、光配向性ポリマー（PA-1、光異性化ポリマー）10質量部および棒状液晶性化合物（N26）90質量部からなる混合物の30質量%シクロヘキサノン溶液2質量部を添加し、ホモジナイザーを用いて乳化した。

セルローストリアセテートフィルム（透明支持体）に、ゼラチン下塗り層を設けた。ゼラチン下塗り層の上に、得られた乳化液を塗布し、乾燥した。形成した厚さ30μmの被膜に、室温で波長435nmの直線偏光（200mW/cm²）を10秒間照射した。偏光照射後、130℃で30分間加熱した。さらに、波長310nmの非偏光（200mW/cm²）を10秒間照射して、光散乱型偏光素子を作製した。

(偏光板の作製)

作製した光散乱型偏光素子と、市販の光吸収型偏光素子とを接着剤を介して積層し、偏光板を作製した。

偏光板を液晶表示装置用バックライトの上に配置した。光散乱型偏光素子の透過軸（光学的等方性連続相の屈折率と光学的異方性不連続相の屈折率とが実質的に等しくなる方向）と光吸収型偏光素子の透過軸とは、平行になるように配置した。その状態で透過率を測定したところ、45.5%であった。

[実施例5]

(円偏光板の作製)

実施例2で作製した偏光板の光散乱型偏光素子側に、 $\lambda/4$ 板を積層して円偏光板を作製した。偏光板の透過軸と $\lambda/4$ 板の遅相軸とは、同一平面で45°の角度で交差するように配置した。

円偏光板の $\lambda/4$ 板側を液晶表示装置用バックライトの上に配置した。その状態で透過率を測定したところ、49%であった。

[参考例1]

市販の光吸収型偏光素子を、液晶表示装置用バックライトの上に配置した。その状態で透過率を測定したところ、41%であった。

[実施例6]

(屈折率の測定)

ゼラチン10質量部を水90質量部に加熱溶解した溶液を高屈折率ガラス上に塗布し、乾燥させた。ゼラチンフィルム（光学的等方性相）の屈折率をアッペ屈折計で測定したところ、いずれの方向も1.54であった。

光配向性ポリマー（PA-5、光二量化ポリマー）の30質量%ジクロロメタン溶液を高屈折率ガラス上に塗布し、乾燥させた後、室温で波長365nmの直線偏光（200mW/cm²）を10秒間照射した。光配向性ポリマーのフィル

ム（光学的異方性相）では偏向方向の屈折率（ n_e ）は1.64、偏向方向と直交方向の屈折率（ n_o ）は1.54であった。

（光散乱型偏光素子の作製）

ゼラチン10質量部を水90質量部に加熱溶解した溶液に、光配向性ポリマー（PA-5、光二量化ポリマー）の30質量%ジクロロメタン溶液を2質量部添加し、ホモジナイザーを用いて分散させた。この液をゼラチン下塗層を設けたセルローストリアセテートフィルム（透明支持体）に塗布し、乾燥させた。さらに、室温で波長365nmの直線偏光（200mW/cm²）を10秒間照射し、光散乱型偏光素子を作製した。

（偏光板の作製）

延伸したポリビニルアルコールフィルムにヨウ素を吸着させて、光吸収型偏光素子を作製した。光吸収型偏光素子の片側に、ポリビニルアルコール系接着剤を用いて、作製した光散乱型偏光素子を、偏光選択層が外側となるように貼り付けた。反対側には、セルローストリアセテートフィルム（フジタック、富士写真フィルム（株）製）を同様にポリビニルアルコール系接着剤を用いて貼り付けた。

作製した偏光板を、光散乱型偏光素子がバックライト側となるように、バックライト上に配置したときの透過率を測定したところ、46%であった。

〔実施例7〕

（屈折率の測定）

光配向性ポリマー（PA-1、光異性化ポリマー）の30質量%シクロヘキサノン溶液を、高屈折率ガラス上に塗布し、乾燥させた後、室温で波長435nmの直線偏光（200mW/cm²）を10秒間照射した。偏光照射後、130℃で30分間加熱処理した。直線偏光照射した光配向性ポリマーのフィルム（光学的異方性相）では偏向方向の屈折率（ n_e ）が1.62、偏向方向と直交方向の屈折率（ n_o ）が1.54であった。

(光散乱型偏光素子の作製)

ゼラチン 10 質量部を水 90 質量部に加熱溶解した溶液に、光配向性ポリマー (PA-1、光異性化ポリマー) の 30 質量%ジクロロメタン溶液を 2 質量部添加し、ホモジナイザーを用いて分散させた。ゼラチン下塗層を設けたセルローストリアセテートフィルム (透明支持体) 上にこの液を塗布し、乾燥させた。さらに、室温で波長 435 nm の直線偏光 ($200 \text{ mW}/\text{cm}^2$) を 10 秒間照射し、偏光照射後、130℃で 30 分間加熱処理し、光散乱型偏光素子を作製した。

(偏光板の作製)

延伸したポリビニルアルコールフィルムにヨウ素を吸着させて、光吸収型偏光素子を作製した。光吸収型偏光素子の片側に、ポリビニルアルコール系接着剤を用いて、作製した光散乱型偏光素子を、偏光選択層が外側となるように貼り付けた。反対側には、セルローストリアセテートフィルム (フジタック、富士写真フィルム (株) 製) を同様にポリビニルアルコール系接着剤を用いて貼り付けた。

作製した偏光板を、光散乱型偏光素子がバックライト側となるように、バックライト上に配置したときの透過率を測定したところ、4.5. 5%であった。

[実施例 8]

(屈折率の測定)

光配向性ポリマー (PA-5、光二量化ポリマー) 10 質量部と棒状液晶性化合物 (N26) 90 質量部との混合物の 30 質量%ジクロロメタン溶液を高屈折率ガラス上に塗布し、乾燥させた後、室温で波長 365 nm の直線偏光 ($200 \text{ mW}/\text{cm}^2$) を 10 秒間照射した。この後、波長 310 nm の非偏光 ($200 \text{ mW}/\text{cm}^2$) を 10 秒間照射し、棒状液晶性化合物を重合させて配向を固定した。直線偏光照射したフィルム (光学異方性相) では偏向方向の屈折率 (n_e) が 1.66、偏向方向と直交方向の屈折率 (n_o) が 1.54 であった。

(光散乱型偏光素子の作製)

ゼラチン 10 質量部を水 90 質量部に加熱溶解した溶液に、光配向性ポリマー

(PA-5、光二量化ポリマー) 10質量部と棒状液晶性化合物(N26) 90質量部との混合物の30質量%ジクロロメタン溶液を2質量部添加し、ホモジナイザーを用いて分散させた。ゼラチン下塗層を設けたセルローストリアセテートフィルム(透明支持体)上にこの液を塗布し、乾燥させた。このフィルムに室温で波長365nmの直線偏光($200\text{mW}/\text{cm}^2$)を10秒間照射した。この後、波長310nmの非偏光($200\text{mW}/\text{cm}^2$)を10秒間照射し、棒状液晶性化合物を重合させて配向を固定し、光散乱型偏光素子を作製した。

(偏光板の作製)

延伸したポリビニルアルコールフィルムにヨウ素を吸着させて、光吸収型偏光素子を作製した。光吸収型偏光素子の片側に、ポリビニルアルコール系接着剤を用いて、作製した光散乱型偏光素子を、偏光選択層が外側となるように貼り付けた。反対側には、セルローストリアセテートフィルム(フジタック、富士写真フィルム(株)製)を同様にポリビニルアルコール系接着剤を用いて貼り付けた。

作製した偏光板を、光散乱型偏光素子がバックライト側となるように、バックライト上に配置したときの透過率を測定したところ、47%であった。

[実施例9]

(屈折率の測定)

光配向性ポリマー(PA-1、光異性化ポリマー) 10質量部と棒状液晶性化合物(N26) 90質量部との混合物の30質量%シクロヘキサノン溶液を高屈折率ガラス上に塗布し、乾燥させた後、室温で波長435nmの直線偏光($200\text{mW}/\text{cm}^2$)を10秒間照射した。偏光照射後、130℃で30分間加熱処理した。この後、波長310nmの非偏光($200\text{mW}/\text{cm}^2$)を10秒間照射し、棒状液晶性化合物を重合させて配向を固定した。直線偏光照射したフィルム(光学異方性相)では偏向方向の屈折率(n_e)が1.65、偏向方向と直交方向の屈折率(n_o)が1.54であった。

(光散乱型偏光素子の作製)

ゼラチン 10 質量部を水 90 質量部に加熱溶解した溶液に、光配向性ポリマー（PA-1、光異性化ポリマー）10 質量部と棒状液晶性化合物（N26）90 質量部 90 質量部との混合物の 30 質量%ジクロロメタン溶液を 2 質量部添加し、ホモジナイザーを用いて分散させた。ゼラチン下塗層を設けたセルローストリアセテートフィルム（透明支持体）上にこの液を塗布し、乾燥させた。このフィルムに室温で波長 435 nm の直線偏光（200 mW/cm²）を 10 秒間照射した。偏光照射後、130℃で 30 分間加熱処理した。この後、波長 310 nm の非偏光（200 mW/cm²）を 10 秒間照射し、棒状液晶性化合物を重合させて配向を固定して、光散乱型偏光素子を作製した。

（偏光板の作製）

延伸したポリビニルアルコールフィルムにヨウ素を吸着させて、光吸収型偏光素子を作製した。光吸収型偏光素子の片側に、ポリビニルアルコール系接着剤を用いて、作製した光散乱型偏光素子を、偏光選択層が外側となるように貼り付けた。反対側には、セルローストリアセテートフィルム（フジタック、富士写真フィルム（株）製）を同様にポリビニルアルコール系接着剤を用いて貼り付けた。

作製した偏光板を、光散乱型偏光素子がバックライト側となるように、バックライト上に配置したときの透過率を測定したところ、46.5%であった。

〔実施例 10〕

（円偏光板の作製）

実施例 7 で作製した偏光板の光散乱型偏光素子側に、 $\lambda/4$ 板を積層して円偏光板を作製した。偏光板の透過軸と $\lambda/4$ 板の遅相軸とは、同一平面で 45° の角度で交差するように配置した。

円偏光板の $\lambda/4$ 板側を液晶表示装置用バックライトの上に配置した。その状態で透過率を測定したところ、50%であった。

〔実施例 11〕

（光学異方性透明支持体の作製）

下記組成のセルロースアセテート溶液をミキシングタンクに投入し、加熱攪拌して溶解した。

セルロースアセテート溶液組成

酢化度 60.9% のセルロースアセテート	100 質量部
TPP (トリフェニルホスフェート)	7.8 質量部
BDP (ビフェニルジフェニルホスフェート)	3.9 質量部
メチレンクロライド	300 質量部
メタノール	54 質量部
1-ブタノール	11 質量部

別のミキシングタンクに、下記の溶液を加熱攪拌、溶解して作製し、上記ドープ 474 質量部に対し 22 質量部添加して充分攪拌混合した。

レターデーション上昇剤溶液組成

2-ヒドロキシ-4-ベンジルオキシベンゾフェノン	12 質量部
2,4-ベンジルオキシベンゾフェノン	4 質量部
メチレンクロライド	80 質量部
メタノール	20 質量部

セルロースアセテート溶液とレターデーション上昇剤溶液との混合液（ドープ）を、流延口からを 0℃ に冷却したドラム上に流延した。フィルムの溶媒含有率 70 質量% の状態で剥取り、両端をピンテンターに固定し、3～5 質量% の領域で機械方向と垂直方向の延伸率 3% となる間隔に保ちつつ乾燥し、その後多数のロールを有する熱処理装置の中を搬送することにより乾燥した。ガラス転移温度である 120℃ を越える領域では、機械方向の延伸率が実質 0% であった。剥取り時に機械方向に 4% 延伸するため、機械方向と垂直方向の延伸率と機械方向の

全延伸率の比は0.75となるようにして、厚さ107 μm のセルロースアセテートフィルムを作製した。

このようにしてセルロースアセテートフィルムを作製した。得られたフィルムの弾性率は、機械方向 (MD) で430 kg/mm^2 、機械方向に垂直な方向 (TD) で360 kg/mm^2 、MD/TD比が1.19であった。また、 R_{th} は80 nm、 R_e は11 nmであった。後述の下塗り後も、支持体フィルム表面への析出が認められず、光学異方性の高いムラのない良好な透明支持体を得られた。

(下塗り層の形成)

光学異方性透明支持体に下記組成の塗布液を28 ml/m^2 塗布、乾燥し、0.1 μm のゼラチン下塗り層を塗設した。

ゼラチン下塗り層塗布液組成

ゼラチン	0.542質量部
ホルムアルデヒド	0.136質量部
サリチル酸	0.160質量部
アセトン	39.1質量部
メタノール	15.8質量部
メチレンクロライド	40.6質量部
水	1.2質量部

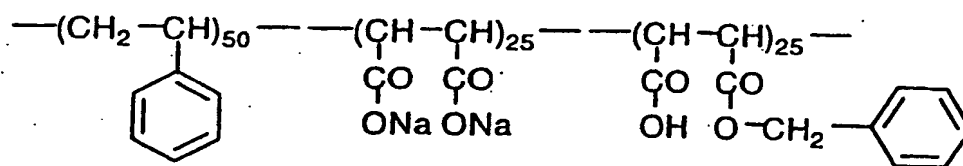
ゼラチン下塗り層の上に下記組成の塗布液を7 ml/m^2 塗布、乾燥して、第2下塗り層を設けた。

第2下塗り層塗布液組成

下記のアニオン性コポリマー	0.079質量部
クエン酸モノエチルエステル	1.01質量部

アセトン	20質量部
メタノール	87.7質量部
水	4.05質量部

アニオン性コポリマー



さらに、光学異方性透明支持体の反対側に、下記組成の塗布液を25ml/m²塗布、乾燥し、バック層を設けた。

バック層塗布液組成

酢化度55%のセルロースジアセテート	0.656質量部
シリカ系マット剤（平均粒径：1μm）	0.065質量部
アセトン	67.9質量部
メタノール	10.4質量部

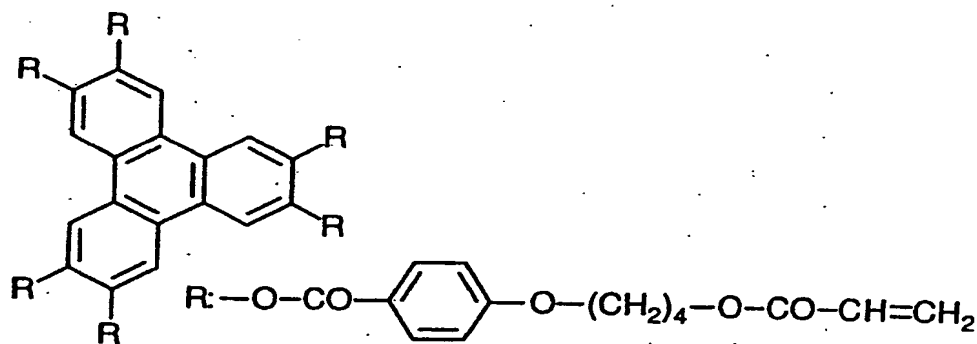
（光学異方性層の形成）

第2下塗り層の上に、厚さ0.5μmのポリビニルアルコール系配向膜を設け、表面をラビング処理した。

配向膜の上に、下記のディスコティック液晶性化合物9.1g、エチレンオキサイド変性トリメチロールプロパントリアクリレート（SP327、大阪有機化学（株）製）0.9g、セルロースアセテートブチレート（CAB551-0.2、イーストマンケミカル社製）0.2g、セルロースアセテートブチレート

(CAB 531-1、イーストマンケミカル社製) 0.05 g、光重合開始剤 (イルガキュアー 907、チバガイギー社製) 3.0 g および光増感剤 (カヤキュアー DETX、日本化薬 (株) 製) 0.1 g を、20.67 g のメチルエチルケトンに溶解した塗布液を、#4 のワイヤーバーで塗布した。これを、金属の枠に貼りつけて 120℃ の高温槽中で 3 分間加熱し、ディスコティック液晶性化合物を配向させた。120℃ のまま高圧水銀灯を用いて 1 分間 UV 照射し、室温まで放冷して、ディスコティック液晶性化合物を含む光学異方性層を形成した。

ディスコティック化合物



光学異方性層の厚さは、1.9 μm であった。光学異方性層と光学異方性透明支持体との積層体 (光学補償シート) のレターデーションを、配向膜のラビング方向に沿って測定したところ、光学軸の平均傾斜角は 18.2°、厚み方向のレターデーション (R_{th}) は 156 nm、面内レターデーション (R_e) は 33 nm であった。

(光学異方性層付き偏光板の作製)

延伸したポリビニルアルコールフィルムにヨウ素を吸着させて、光吸収型偏光素子を作製した。光吸収型偏光素子の片側に、ポリビニルアルコール系接着剤を用いて、光学異方性層と光学異方性透明支持体との積層体を、光学異方性層が外側となるように貼り付けた。反対側には、ポリビニルアルコール系接着剤を用いて、実施例 6 で作製した光散乱型偏光素子を偏光選択層が外側となるように貼り

付けた。

光吸収型偏光素子の透過軸と、光学異方性層と光学異方性透明支持体との積層体の遅相軸とは、平行になるように配置した。更に光吸収型偏光素子の透過軸と、光散乱型偏光素子の透過軸（ n_e 方向）も平行になるように配置し、光学異方性層付き偏光板を作製した。

光学異方性層付き偏光板をアクリル系接着剤を用いてガラス板に貼り付け、高温、加圧下でエイジングした後、 90°C の恒温槽に入れ、500時間放置した。偏光板を調べたところ、剥離、泡の発生あるいは皺の発生のような問題は全く認められなかった。さらに500時間（合計1000時間） 90°C の恒温槽に入れてから調べても、剥離、泡の発生あるいは皺の発生のような問題は全く認められなかった。

[実施例 12]

(液晶表示装置の作製)

ITO透明電極が設けられたガラス基板の上に、ポリイミド配向膜を設け、ラビング処理を行った。 $5\mu\text{m}$ のスペーサーを介して、二枚の基板を配向膜が向かい合うように重ねた。配向膜のラビング方向が直交するように、基板の向きを調節した。基板の隙間に、棒状液晶性分子（ZL4792、メルク社製）を注入し、液晶層を形成した。液晶性分子の Δn は0.0969であった。

以上のように作製したTN液晶セルのバックライト側に、実施例11で作製した光学異方性層付き偏光板を貼り付け、反対側には光散乱型偏光素子がない光学異方性層付き偏光板を貼り付けて、液晶表示装置を作製した。光学異方性層と光学異方性透明支持体との積層体の遅相軸と、液晶セルのラビング方向とは、直交するように配置した。

具体的な層構成は、以下の順序の通りである。

透明支持体 (1)

光吸収型偏光素子 (2)

光学異方性透明支持体 (3)

光学異方性層 (4)

TNモードの液晶セル (5)

光学異方性層 (6)

光学異方性透明支持体 (7)

光吸収型偏光素子 (8)

透明支持体 (9)

光散乱型偏光素子 (10)

バックライト (11)

液晶表示装置の液晶セルに、電圧を印加し、白表示2V、黒表示5Vにおける白表示と黒表示との透過率の比をコントラスト比として、上下左右でコントラスト比が10、かつ階調反転のない領域を視野角として測定した。その結果、上下の視野角は125°、左右の視野角は165°であった。また、正面コントラストは、230であった。

従来の偏光板を用いた液晶表示装置と比較したところ、正面輝度が約40%上昇した。

[実施例13]

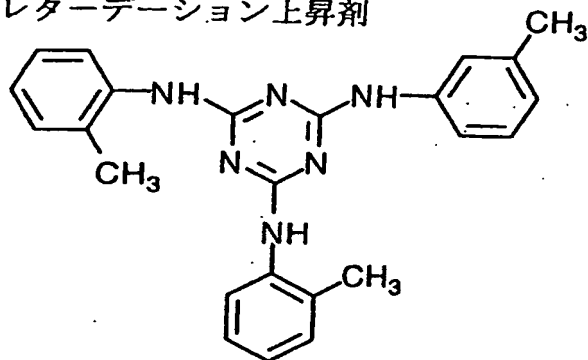
(光学異方性透明支持体の作製)

室温において、平均酢化度60.9%のセルロースアセテート45質量部、下記のレターデーション上昇剤1.62質量部、メチレンクロリド232.72質量部、メタノール42.57質量部およびn-ブタノール8.50質量部を混合して、溶液(ドープ)を調製した。

得られたドープを、有効長6mのバンド流延機を用いて、乾燥膜厚が100μmになるように流延して乾燥した。

得られたセルロースアセテートフィルム(光学異方性透明支持体)について、エリプソメーター(M-150、日本分光(株)製)を用いて、波長550nmにおけるレターデーションを測定したところ、Reレターデーション値が5nm、Rthレターデーション値が120nmであった。

レターデーション上昇剤



(光学異方性層の形成)

光学異方性透明支持体にゼラチン下塗り層を設けた。

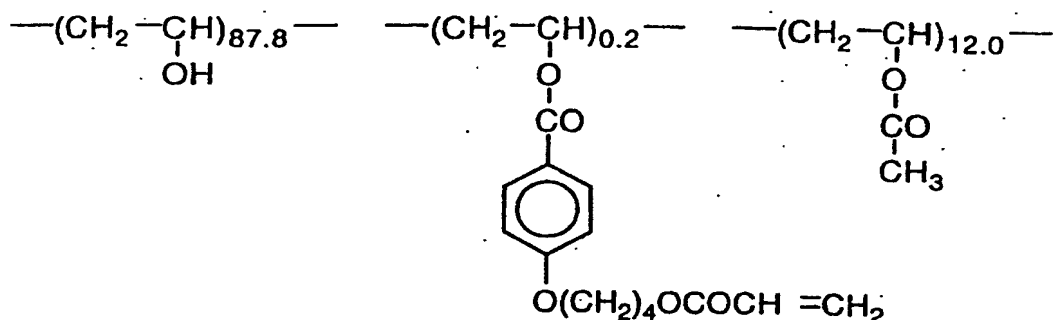
ゼラチン下塗り層の上に、下記の組成の塗布液を#16のワイヤーバーコーターで 28 ml/m^2 塗布した。60℃の温風で60秒、さらに90℃の温風で150秒乾燥した。

次に、光学異方性透明支持体の遅相軸（波長632.8nmで測定）と45°の方向に、形成した膜に対してラビング処理を実施した。

配向膜塗布液組成

下記の変性ポリビニルアルコール	10質量部
水	371質量部
メタノール	119質量部
グルタルアルデヒド（架橋剤）	0.5質量部

変性ポリビニルアルコール



配向膜上に、実施例 11 で用いたディスコティック液晶性化合物 41.01 g、エチレンオキサイド変成トリメチロールプロパントリアクリレート (V#360、大阪有機化学 (株) 製) 4.06 g、セルロースアセテートブチレート (CAB551-0.2、イーストマンケミカル社製) 0.90 g、セルロースアセテートブチレート (CAB531-1、イーストマンケミカル社製) 0.23 g、光重合開始剤 (イルガキュアー 907、チバガイギー社製) 1.35 g、増感剤 (カヤキュアー DETX、日本化薬 (株) 製) 0.45 g を、102 g のメチルエチルケトンに溶解した塗布液を、#3 のワイヤーバーで塗布した。これを金属の枠に貼り付けて、130℃の恒温槽中で2分間加熱し、ディスコティック液晶性化合物を配向させた。次に、130℃で120W/cm 高圧水銀灯を用いて、1分間UV照射しディスコティック化合物を重合させた。その後、室温まで放冷した。このようにして、光学異方性層を形成した。

波長 546 nm で測定した光学異方性層の R e レターデーション値は 38 nm であった。また、円盤面と光学異方性透明支持体面との間の平均角度 (平均傾斜角) は 40° であった。

(楕円偏光板の作製)

光学異方性透明支持体をアルカリ浴槽中でケン化処理し、ポリビニルアルコールとヨウ素とからなる光吸収型偏光素子の一方の面に接着剤を介して貼り合わせ

た。さらに、光学異方性層と光学異方性透明支持体との積層体の光学異方性透明支持体面と、光吸収型偏光素子と光学異方性透明支持体との積層体の光学異方性透明支持体面とを粘着剤を介して貼り合わせた。

光吸収型偏光素子の透過軸と、二枚の光学異方性透明支持体の遅相軸とは、全て平行に配置した。

光吸収型偏光素子のもう一方の面に、光散乱型偏光素子を、光吸収型偏光素子の透過軸と光散乱型偏光素子の透過軸（ n_e 方向）とが平行になるように、接着剤を介して貼り合わせ、楕円偏光板を作製した。

（第2楕円偏光板の作製）

光散乱型偏光素子の代わりに、光学的等方性セルローストリアセテートフィルムを用いた以外は楕円偏光板の作製と同様にして、第2楕円偏光板を作製した。

（ベンド配向液晶セルの作製）

I T O 電極付きのガラス基板に、ポリイミド膜を配向膜として設け、配向膜にラビング処理を行った。得られた二枚のガラス基板をラビング方向が平行となる配置で向かい合わせ、セルギャップを $6\ \mu\text{m}$ に設定した。セルギャップに Δn が 0.1396 の液晶性化合物（Z L I 1 1 3 2、メルク社製）を注入し、ベンド配向液晶セルを作製した。

（液晶表示装置の作製）

作製したベンド配向セルを挟むように、作製した楕円偏光板と第2楕円偏光板とを貼り付けた。楕円偏光板は光散乱型偏光素子がバックライト側になるように貼り付け、楕円偏光板は光学的等方性セルローストリアセテートフィルムが視認側になるように貼り付けた。そして、各楕円偏光板の光学異方性層がセル基板に対面し、液晶セルのラビング方向とそれに対面する光学異方性層のラビング方向とが反平行となるように配置した。

〔実施例 1 4〕

(透明支持体の作製)

厚さ100 μ mのセルローストリアセテートフィルムに、厚さ0.1 μ mのゼラチン下塗り層を設けて、透明支持体を作製した。

波長546nmにおけるレターデーションを測定したところ、Reレターデーション値が0.6nm、Rthレターデーション値が35nmであった。

(配向膜の形成)

透明支持体のゼラチン下塗り層の上に、実施例13で用いた配向膜塗布液を#16のワイヤーバーコーターで28ml/m²塗布した。60℃の温風で60秒、さらに90℃の温風で150秒乾燥した。

次に、透明支持体の遅相軸（波長632.8nmで測定）と45°の方向に、形成した膜に対してラビング処理を実施した。

(光学異方性層の形成)

配向膜上に、実施例11で用いたディスコティック液晶性化合物41.01g、エチレンオキサイド変成トリメチロールプロパントリアクリレート（V#360、大阪有機化学（株）製）4.06g、セルロースアセテートブチレート（CAB551-0.2、イーストマンケミカル社製）0.90g、セルロースアセテートブチレート（CAB531-1、イーストマンケミカル社製）0.23g、光重合開始剤（イルガキュアー907、チバガイギー社製）1.35g、増感剤（カヤキュアーDET-X、日本化薬（株）製）0.45gを、102gのメチルエチルケトンに溶解した塗布液を、#3のワイヤーバーで塗布した。これを金属の枠に貼り付けて、130℃の恒温槽中で2分間加熱し、ディスコティック液晶性化合物を配向させた。次に、130℃で120W/cm高圧水銀灯を用いて、1分間UV照射しディスコティック化合物を重合させた。その後、室温まで放冷した。このようにして、光学異方性層を形成した。

波長546nmで測定した光学異方性層のReレターデーション値は38nmであった。また、円盤面と透明支持体面との間の平均角度（平均傾斜角）は40°であった。

(楕円偏光板の作製)

透明支持体をアルカリ浴槽中でケン化処理した。その透明支持体面を、ポリビニルアルコールとヨウ素とからなる光吸収型偏光素子の一方の面に接着剤を介して貼り合わせた。さらに、光学異方性層と透明支持体との積層体の透明支持体面と、光吸収型偏光素子と透明支持体との積層体の透明支持体面とを粘着剤を介して貼り合わせた。

光吸収型偏光素子の透過軸は、透明支持体の遅相軸と直交させた。

光吸収型偏光素子のもう一方の面に、光散乱型偏光素子を、光吸収型偏光素子の透過軸と光散乱型偏光素子の透過軸（ n_e 方向）とが平行になるように、接着剤を介して貼り合わせ、楕円偏光板を作製した。

(第2楕円偏光板の作製)

光散乱型偏光素子の代わりに、光学的等方性セルローストリアセテートフィルムを用いた以外は楕円偏光板の作製と同様にして、第2楕円偏光板を作製した。

(水平配向液晶セルの作製)

I T O 電極付きのガラス基板に、ポリイミド膜を配向膜として設け、配向膜にラビング処理を行った。得られた二枚のガラス基板をラビング方向が反平行となる配置で向かい合わせ、セルギャップを $3.7 \mu\text{m}$ に設定した。セルギャップに Δn が 0.0988 の液晶性化合物（Z L I 4 7 9 2、メルク社製）を注入し、水平配向液晶セルを作製した。

(液晶表示装置の作製)

作製した水平配向セルを挟むように、作製した楕円偏光板と第2楕円偏光板とを貼り付けた。楕円偏光板は光散乱型偏光素子がバックライト側になるように貼り付け、第2楕円偏光板は光学的等方性セルローストリアセテートフィルムが視認側になるように貼り付けた。そして、二枚の楕円偏光板の光学異方性層がセル基板に対面し、液晶セルのラビング方向とそれに対面する光学異方性層のラビン

グ方向とが反平行となるように配置した。

(液晶表示装置の評価)

実施例 1 3 および 1 4 で作製した液晶表示装置について、視野角と明るさを評価した。結果を第 1 表に示す。

第 1 表

液晶表示装置	表示モード	視野角 (上/下/左/右)	明るさ
実施例 1 3	ベンド配向	80° / 70° / 73° / 73°	600 cd
実施例 1 4	水平配向	75° / 45° / 56° / 55°	450 cd

[実施例 1 5]

(偏光選択層用塗布液の調製)

市販の棒状液晶性化合物 (E 9、メルク・ジャパン (株) 製) 7.2 g、ポリビニルシンナメート 0.3 g、2-エチルヘキシルアクリレート 2.4 g、光重合開始剤 (イルガキュア 907、チバガイギー社製) 0.1 g をジクロロメタン 40 g に溶解し、孔径 30 μm のテフロン製フィルターでろ過して、偏光選択層用塗布液を調製した。

(光散乱型偏光素子の作製)

80 μm の厚さのセルローストリアセテートフィルム (TAC-TD80U、富士写真フィルム (株) 製) に、偏光選択層用塗布液をバーコーターを用いて塗布し、120℃で乾燥の後、偏光紫外線露光装置 ((株) ニコン技術工房製) を用いて、照度 30 mW/cm²、照射量 400 mJ/cm² の直線偏光紫外線を照射して塗布層を硬化させ、厚さ 15 μm の偏光選択層を形成することにより光散乱型偏光素子を作製した。

(偏光板の作製)

作製した光散乱型偏光素子と、市販の光吸収型偏光素子とを接着剤を介して積層し、偏光板を作製した。

[実施例 16]

(偏光選択層用塗布液の調製)

棒状液晶性化合物 (N26) を 4.5 g、ジペンタエリスリトールペンタアクリレートとジペンタエリスリトールヘキサアクリレートの混合物 (DPHA、日本化薬 (株) 製) 0.3 g、光配向性ポリマー (PA-1、光異性化ポリマー) 0.1 g、光重合開始剤 (イルガキュア 907、チバガイギー社製) 0.1 g を酢酸エチル 15.0 g に溶解し、孔径 30 μm のポリプロピレン製フィルターでろ過して、光学的異方性相を調製した。

一方、ゼラチン (681、新田ゼラチン (株) 製) 10 g を水 90 g に溶解し、さらに界面活性剤としてドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム 0.2 g を添加、溶解後、孔径 30 μm のポリプロピレン製フィルターでろ過して、光学的等方性相を調製した。

光学的異方性相 10 g と光学的等方性相 10 g とを混合した液を 60℃ に加温し、超音波分散によりこの液を分散して偏光選択層用塗布液を調製した。

(光散乱型偏光素子の作製)

ゼラチン下塗り層を有する 100 μm の厚さのセルローストリアセテートフィルム (富士写真フイルム (株) 製) に、上記の偏光選択層用塗布液をカーテンコート法により塗布し、10℃ にてゼラチンをセットさせた後、25℃ で乾燥の後、160 W/cm の空冷メタルハライドランプ (アイグラフィックス (株) 製、波長範囲 200 ~ 500 nm、最大波長 365 nm) を用い、光をコリメートして平行光にしてから入射角 45°、照度 200 mW/cm²、照射量 400 mJ/cm² の紫外線を照射して塗布層を硬化させ、厚さ 30 μm の偏光選択層を形成することにより光散乱型偏光素子を作製した。

(偏光板の作製)

作製した光散乱型偏光素子と、市販の光吸収型偏光素子とを接着剤を介して積層し、偏光板を作製した。

[実施例 17]

(偏光選択層用塗布液の調製)

光配向性ポリマー (PA-5、光二量化ポリマー) 4.6 g、ジペンタエリスリトールペンタアクリレートとジペンタエリスリトールヘキサアクリレートの混合物 (DPHA、日本化薬 (株) 製) 0.3 g、光重合開始剤 (イルガキュア 907、チバガイギー社製) 0.1 g を酢酸エチル 15.0 g に溶解し、孔径 30 μm のポリプロピレン製フィルターでろ過して、光学的異方性相を調製した。

光学的異方性相 10 g と実施例 16 で調製した光学的等方性相 10 g とを混合した液を 60℃ に加温し、超音波分散によりこの液を分散して偏光選択層用塗布液を調製した。

(光散乱型偏光素子の作製)

80 μm の厚さのセルローストリアセテートフィルム (TAC-TD80U、富士写真フィルム (株) 製) に、上記の偏光選択層用塗布液をカーテンコート法により塗布し、10℃ にてゼラチンをセットさせた後、25℃ で乾燥の後、偏光紫外線露光装置 ((株) ニコン技術工房製) を用いて、照度 30 mW/cm^2 、照射量 400 mJ/cm^2 の直線偏光紫外線を照射して塗布層を硬化させ、厚さ 30 μm の偏光選択層を形成することにより光散乱型偏光素子を作製した。

(偏光板の作製)

作製した光散乱型偏光素子と、市販の光吸収型偏光素子とを接着剤を介して積層し、偏光板を作製した。

[比較例 1]

(偏光選択層用塗布液の調製)

市販の棒状液晶性化合物（E 9、メルク・ジャパン（株）製）7.5 g、2-エチルヘキシルアクリレート2.4 g、光重合開始剤（イルガキュア907、チバガイギー社製）0.1 gをジクロロメタン40 gに溶解し、孔径30 μm のテフロン製フィルターでろ過して、偏光選択層用塗布液を調製した。

（光散乱型偏光素子の作製）

80 μm の厚さのセルローストリアセテートフィルム（TAC-TD80U、富士写真フィルム（株）製）に、上記の偏光選択層用塗布液をバーコーターを用いて塗布し、120°Cで乾燥の後、偏光紫外線露光装置（（株）ニコン技術工房製）を用いて、照度30 mW/cm²、照射量400 mJ/cm²の直線偏光紫外線を照射して塗布層を硬化させ、厚さ15 μm の偏光選択層を形成することにより光散乱型偏光素子を作製した。

（偏光板の作製）

作製した光散乱型偏光素子と、市販の光吸収型偏光素子とを接着剤を介して積層し、偏光板を作製した。

〔比較例2〕

実施例15の光散乱型偏光素子の作製において、光を照射しなかったこと以外は同様にして、光散乱型偏光素子および偏光板を作製した。

（光散乱型偏光素子の評価）

1. 屈折率

光学的異方性相および光学的等方性相の屈折率をアッベ屈折率計により測定した。光学的異方性相の屈折率を測定する際には、光学的異方性化合物に光配向性化合物を混合した液を高屈折率ガラスに塗布し、直線偏光を照射して配向させてから測定した。光学的等方性相は、ポリマーそのものあるいは必要に応じて添加した添加剤を含んだものを高屈折率ガラスに塗布し、測定した。

屈折率の測定結果を第2表に示す。

第 2 表

光散乱型偏光素子	光学的異方性化合物		光学的等方性化合物
	n 1	n 2	n 3
実施例 1 5	1. 7 8	1. 5 3	1. 5 3
実施例 1 6	1. 6 6	1. 5 3	1. 5 3
実施例 1 7	1. 6 4	1. 5 3	1. 5 3
比較例 1	1. 7 8	1. 5 3	1. 5 3
比較例 2	1. 7 8	1. 5 3	1. 5 3

2. 光線透過率、光散乱性 (ヘイズ)

光散乱型偏光素子の光線透過率および光散乱性 (ヘイズ) をヘイズメーター (MODEL 1001DP、日本電色工業 (株) 製) を用いて測定した。測定は光源とフィルムの間に偏光素子を挿入して行い、偏光素子の透過軸と偏光選択層の透過軸を同じにしたものを平行、直交させたものを直交として。光線透過率は全光線透過率を、光散乱性はヘイズを指標として評価した。偏光選択性がある場合、平行の方が直交に比べて高透過率、低ヘイズとなる。

光線透過率、光散乱性の測定結果を第 3 表に示す。

3. 面状

光散乱型偏光素子の面状を、透過軸を直交させた 2 枚の偏光素子の間に試料を挟み、偏光素子の間で試料の方向を回転させながら観察した。測定結果は第 3 表に示す。

第 3 表

光散乱型 偏光素子	全光線透過率		ヘイズ		面状
	平行	直交	平行	直交	

実施例 1 5	8 5 . 3	4 6 . 2	5 . 3	8 2 . 3	均一
実施例 1 6	8 0 . 2	5 5 . 7	1 0 . 2	6 3 . 8	均一
実施例 1 7	8 2 . 9	5 1 . 0	8 . 8	7 9 . 4	均一
比較例 1	5 9 . 2	6 1 . 4	2 8 . 2	2 8 . 6	散乱の異方性なし
比較例 2	6 7 . 4	6 6 . 3	3 1 . 8	3 3 . 3	散乱の異方性なし

註：全光線透過率の単位は、%である。

実施例 1 5 ～ 1 7 の光散乱型偏光素子の透過率は、いずれも平行では 8 0 % 以上、直交で 2 0 % 以下となり高い偏光選択性を示した。実施例 1 5 ～ 1 7 はいずれもほとんど着色が無いため、ここで直交における透過しなかった光は全て後方散乱されたと考えられる。このフィルムを液晶表示装置に用いることにより、大きな光の利用効率の向上が期待できる。

実施例 1 6 は、本来の光学的異方性化合物の有する Δn に比べると偏光選択性が小さかったが、これは光照射により十分に異方性が発揮されなかったためであり、直線偏光照射の方がより優れた性能となることを示している。

比較例 1、2 は偏光選択性を示さなかった。これは比較例 1 は光配向性化合物を含まなかったため、比較例 2 は光照射を行わなかったため、光学的異方性化合物が配向しなかったためと考えられる。実際、4 0 0 倍の偏光顕微鏡下で観察を行ったところ、小さなドメイン内で任意の方向に配向していた。

[実施例 1 8]

(光の利用効率改善の確認)

実施例 1 7 で作製した偏光板をアルミニウムでできた反射板の上に偏光選択層を反射板側にして置いて観察したところ、光散乱型偏光素子の方が反射板が明るく見えた。これは外光が反射板で反射し、反射光が偏光選択層において透過軸の偏光のみ透過し、後方散乱した光が再度反射板で反射して偏光選択層に到達することによって光の利用効率が上がったことを示している。

[実施例 19]

実施例 17 の偏光板を用い、図 4 に示す構成の液晶表示装置を作製した。

[比較例 3]

光学干渉による偏光選択層を有する市販の輝度上昇フィルム（DBEF、3M 製）を用い、図 4 に示す構成の液晶表示装置を作製した。

（液晶表示装置の評価）

光散乱型偏光素子を用いた実施例 19 の液晶表示装置は、正面だけでなく斜めから見たときも明らかに輝度の上昇が見られた。一方、比較例 3 の液晶表示装置は、正面は輝度が上昇しているものの、斜めから見たときはほとんど輝度の上昇はなかった。

[実施例 20]

（偏光選択層用塗布液の調製）

4'-ペンチル-4-ビフェニルカルボニトリル 400 g をポリメチルメタクリレート のメチルエチルケトン 20 質量% 溶液 500 g に混合し、孔径 30 μm のテフロン製フィルターでろ過して、偏光選択層用塗布液を調製した。

（光散乱型偏光素子の作製）

偏光選択層用塗布液をダイを用いてバンド流延、乾燥し、厚み 40 μm となるようにした。このフィルムをバンドから剥ぎ取り、ドライで 25℃ にて 1.1 倍延伸の後、そのままケン化した厚さ 80 μm のセルローストリアセテートフィルム（富士写真フィルム（株）製）にポリビニルアルコール（PVA117、クラレ（株））5 質量% 水溶液を糊としてラミネートした。このフィルムを 120℃ で乾燥し、光散乱型偏光素子を作製した。

（偏光板の作製）

市販のヨウ素系偏光板から片側の保護フィルムを剥がし、光散乱型偏光素子を、偏光選択層のないケン化されたセルローストリアセテートフィルム面がヨウ素を含有する偏光層と貼り合わせるように接着して、偏光板を作製した。

[実施例 2 1]

(偏光選択層用塗布液の調製)

4'-ペンチル-4-ビフェニルカルボニトリル 100 g をポリビニルアルコール (PVA 205、クラレ (株) 製) の 20 質量% 水溶液 1500 g に混合し、超音波分散によりこの液を分散して偏光選択層用塗布液を調製した。

(光散乱型偏光素子の作製)

偏光選択層用塗布液をダイを用いてバンド流延、乾燥し、厚み $40\ \mu\text{m}$ となるようにした。このフィルムを含水率 10% の状態でバンドから剥ぎ取り、そのままケン化した厚さ $80\ \mu\text{m}$ のセルローストリアセテートフィルム (富士写真フィルム (株) 製) ラミネートした。このフィルムを 120°C で乾燥し、光散乱型偏光素子を作製した。

(偏光板の作製)

市販のヨウ素系偏光板から片側の保護フィルムを剥がし、光散乱型偏光素子を、偏光選択層のないケン化されたセルローストリアセテートフィルム面がヨウ素を含有する偏光層と貼り合わせるように接着して、偏光板を作製した。

[実施例 2 2]

(光散乱型偏光素子の作製)

実施例 2 1 で調製した偏光選択層用塗布液をダイを用いてバンド流延、乾燥し、厚み $40\ \mu\text{m}$ となるようにした。このフィルムをバンドから剥ぎ取り、ドライで 25°C にて 1.1 倍延伸の後、そのままケン化した厚さ $80\ \mu\text{m}$ のセルローストリアセテートフィルム (富士写真フィルム (株) 製) にポリビニルアルコール (PVA 117、クラレ (株)) 5 質量% 水溶液を糊としてラミネートした。こ

のフィルムを120℃で乾燥し、光散乱型偏光素子を作製した。

(偏光板の作製)

市販のヨウ素系偏光板から片側の保護フィルムを剥がし、光散乱型偏光素子を、偏光選択層のないケン化されたセルローストリアセテートフィルム面がヨウ素を含有する偏光層と貼り合わせるように接着して、偏光板を作製した。

[実施例23]

(偏光選択層用塗布液の調製)

棒状液晶性化合物(N26)48g、ジペンタエリスリトールペンタアクリレートとジペンタエリスリトールヘキサアクリレートの混合物(DPHA、日本化薬(株)製)1.0g、光重合開始剤(イルガキュア907、チバガイギー社製)1.0gを酢酸エチル150gに溶解し、孔径30 μ mのポリプロピレン製フィルターでろ過して、光学的異方性相を調製した。

一方、ポリビニルアルコール(PVA205、クラレ(株)製)20質量%水溶液2000gに、界面活性剤としてドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム4.0gを添加、溶解後、孔径30 μ mのポリプロピレン製フィルターでろ過して、光学的等方性相を調製した。

光学的異方性相200gと光学的等方性相200gとを混合した液を、超音波分散によりこの液を分散して偏光選択層用塗布液を調製した。

(光散乱型偏光素子の作製)

偏光選択層用塗布液をダイを用いて厚さ6 μ mのポリエチレンテレフタレートフィルム上に塗布、乾燥し、偏光選択層の厚みが30 μ mとなるようにした。このフィルムを支持体ごとドライで115℃にて1.25倍延伸の後、90℃で2分間熟成してから、160W/cmの空冷メタルハライドランプ(アイグラフィックス(株)製、波長範囲200~500nm、最大波長365nm)を用いて、照度200mW/cm²、照射量400mJ/cm²の紫外線を照射して光学的異方性相を硬化させ、光散乱型偏光素子を作製した。

(偏光板の作製)

市販のヨウ素系偏光板から片側の保護フィルムを剥がし、光散乱型偏光素子を、偏光選択層のないケン化されたセルローストリアセテートフィルム面がヨウ素を含有する偏光層と貼り合わせるように接着して、偏光板を作製した。

[実施例 2 4]

(偏光選択層用塗布液の調製)

4'-ペンチル-4-ビフェニルカルボニトリル 100 g を実施例 2 3 で調製した光学的等方性相 1500 g に混合し、超音波分散によりこの液を分散して偏光選択層用塗布液を調製した。

(光散乱型偏光素子の作製)

偏光選択層用塗布液をダイを用いてバンド流延、乾燥し、厚み 40 μm となるようにした。このフィルムをバンドから剥ぎ取り、ドライで 25℃ にて 1.1 倍延伸の後、そのままゼラチン下塗りした厚さ 100 μm のセルローストリアセテートフィルム (富士写真フィルム (株) 製) にポリビニルアルコール (PVA 117、クラレ (株)) 5 質量% 水溶液を糊としてラミネートした。このフィルムを 120℃ で乾燥し、光散乱型偏光素子を作製した。

(偏光板の作製)

市販のヨウ素系偏光板から片側の保護フィルムを剥がし、光散乱型偏光素子を、偏光選択層のないケン化されたセルローストリアセテートフィルム面がヨウ素を含有する偏光層と貼り合わせるように接着して、偏光板を作製した。

[実施例 2 5]

(偏光選択層用塗布液の調製)

ポリビニルアルコール (PVA 205、クラレ (株) 製) 100 g、アルキル変性ポリビニルアルコール (MP 203、クラレ (株) 製) 300 g、界面活性

剤としてドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム0.2 g、可塑剤としてグリセリン2.0 gを水1600 gに溶解し、光学的等方性相を調製した。

4'-ペンチル-4-ビフェニルカルボニトリル100 g、グルタルアルデヒド4 gを光学的等方性相1500 gに混合し、超音波分散によりこの液を分散して偏光選択層用塗布液を調製した。

(光散乱型偏光素子の作製)

偏光選択層用塗布液をダイを用いてバンド流延、乾燥し、厚み100 μ mとなるようにした。このフィルムをバンドから剥ぎ取り、ドライで25℃にて1.2倍延伸の後、そのままケン化した厚さ80 μ mのセルローストリアセテートフィルム（富士写真フィルム（株）製）にポリビニルアルコール（PVA117、クラレ（株））5質量%水溶液を糊としてラミネートした。このフィルムを120℃で乾燥し、光散乱型偏光素子を作製した。

(偏光板の作製)

市販のヨウ素系偏光板から片側の保護フィルムを剥がし、光散乱型偏光素子を、偏光選択層のないケン化されたセルローストリアセテートフィルム面がヨウ素を含有する偏光層と貼り合わせるように接着して、偏光板を作製した。

[実施例26]

(光散乱型偏光素子の作製)

実施例25で調製した偏光選択層用塗布液をダイを用いてバンド流延、乾燥し、厚み40 μ mとなるようにした。このフィルムをバンドから剥ぎ取り、ドライで25℃にて1.2倍延伸した。次いでホウ酸100 g/lの水溶液中に70℃にて5分間浸漬し、さらに水洗槽で20℃、10秒間水洗して、さらに80℃で5分間乾燥し、そのままケン化したセルローストリアセテートフィルム（富士写真フィルム（株）製）にポリビニルアルコール（PVA117、クラレ（株））5質量%水溶液を糊としてラミネートした。このフィルムを120℃で乾燥し、光散乱型偏光素子を作製した。

(偏光板の作製)

市販のヨウ素系偏光板から片側の保護フィルムを剥がし、光散乱型偏光素子を、偏光選択層のないケン化されたセルローストリアセテートフィルム面がヨウ素を含有する偏光層と貼り合わせるように接着して、偏光板を作製した。

[比較例 4]

(偏光選択層用塗布液の調製)

4'-ペンチル-4-ビフェニルカルボニトリル 400 g をポリカーボネートのメチレンクロライド 5 質量% 溶液 2000 g に混合し、孔径 30 μm のテフロン製フィルターでろ過して、偏光選択層用塗布液を調製した。

(光散乱型偏光素子の作製)

偏光選択層用塗布液をダイを用いてバンド流延、乾燥し、厚み 40 μm となるようにした。このフィルムをバンドから剥ぎ取り、ドライで 25℃ にて 1.1 倍延伸の後、そのままケン化した厚さ 80 μm のセルローストリアセテートフィルム（富士写真フィルム（株）製）に市販の粘着剤を介してラミネートした。このフィルムを 120℃ で乾燥し、光散乱型偏光素子を作製した。

(偏光板の作製)

市販のヨウ素系偏光板から片側の保護フィルムを剥がし、光散乱型偏光素子を、偏光選択層のないケン化されたセルローストリアセテートフィルム面がヨウ素を含有する偏光層と貼り合わせるように接着して、偏光板を作製した。

[比較例 5]

(偏光選択層用塗布液の調製)

ビフェニル 100 g をポリビニルアルコール（PVA 205、クラレ（株）製）の 20 質量% 水溶液 1500 g に混合し、70℃ にて超音波分散によりこの液を分散して偏光選択層用塗布液を調製した。

(光散乱型偏光素子の作製)

偏光選択層用塗布液をダイを用いてバンド流延、乾燥し、厚み $40\mu\text{m}$ となるようにした。このフィルムをバンドから剥ぎ取り、ドライで 25°C にて1.1倍延伸の後、そのままケン化した厚さ $80\mu\text{m}$ のセルローストリアセテートフィルム（富士写真フィルム（株）製）にポリビニルアルコール（PVA117、クラレ（株））5質量%水溶液を糊としてラミネートした。このフィルムを 120°C で乾燥し、光散乱型偏光素子を作製した。

(偏光板の作製)

市販のヨウ素系偏光板から片側の保護フィルムを剥がし、光散乱型偏光素子を、偏光選択層のないケン化されたセルローストリアセテートフィルム面がヨウ素を含有する偏光層と貼り合わせるように接着して、偏光板を作製した。

[比較例6]

延伸しない以外は実施例23と同様にして、光散乱型偏光素子を作製した。

(偏光板の作製)

市販のヨウ素系偏光板から片側の保護フィルムを剥がし、光散乱型偏光素子を、偏光選択層のないケン化されたセルローストリアセテートフィルム面がヨウ素を含有する偏光層と貼り合わせるように接着して、偏光板を作製した。

(光散乱型偏光素子の評価)

1. 複屈折

連続相の複屈折は不連続相を含まないフィルムに関し、同じ延伸倍率で延伸したフィルムについてMDおよびTD方向の屈折率をアッベ屈折率計により測定した。

2. 光線透過率、光散乱性（ヘイズ）

光散乱型偏光素子の光線透過率および光散乱性（ヘイズ）をヘイズメーターMODEL 1001DP（日本電色工業（株）製）を用いて測定した。測定は光源とフィルムの上に偏光子を挿入して行い、偏光子の透過軸と偏光選択層の透過軸を同じにしたものを平行、直交させたものを直交として。光線透過率は全光線透過率を、光散乱性はヘイズを指標として評価した。偏光選択性がある場合、平行の方が直交に比べて高透過率、低ヘイズとなる。

3. 不連続相粒径

光散乱型偏光素子の偏光選択層の不連続相粒径は、ミクロトームにて断面を切削し、走査型電子顕微鏡にて500.0倍で観察した写真から、任意に100個の不連続相を抽出し、円相当半径に換算して測定した。

評価結果を第4表に示す。実施例20～26の透過率はいずれも平行では60%以下、直交で75%以上となり高い偏光選択性を示した。

実施例20と23が他に比べてやや偏光選択性が小さいが、これはいずれも不連続相の粒径が大きいことが影響している。不連続相が小さい方が液晶分子の配向度が大きくなるためである。また実施例23については液晶分子の固有複屈折が小さいことも一因である。

実施例21は、延伸工程がなかったにも関わらず偏光選択性を示しているが、これは剥ぎ取り時の応力によって不連続相の液晶が配向したためと考えられる。

また実施例22、23、25、26の光散乱型偏光素子を温度40℃、相対湿度80%の高温高湿下にて3日間保存したところ、実施例22と25は著しくカールしてほとんど偏光選択性を示さなくなったのに対し、実施例23は偏光選択性が全く変わらなかった。これは液晶性分子の重合によって配向が固定化されたためと考えられる。実施例16はわずかに偏光選択性が悪化した。これは連続相が架橋によって湿度の影響を受け難くなったためと考えられる。

比較例4～6はほとんど偏光選択性を示さなかった。比較例4は連続相の複屈折が大きく、しかも延伸方向の屈折率が大きくなるため、不連続相との屈折率差の異方性が小さくなったためである。

比較例 5 は不連続相に液晶性を示さない化合物を用いたため、延伸によってほとんど分子が配向しなかったためと考えられる。

比較例 6 は全く延伸していないため、不連続相の液晶分子が配向しなかったためである。

第 4 表

光散乱型 偏光素子	複屈折	全光線透過率		ヘイズ		不連続相 の粒径
		平行	直交	平行	直交	
実施例 20	< 0. 0 1	5 6. 7	7 8. 6	7 8. 1	3 4. 8	2. 1 μm
実施例 21	< 0. 0 1	5 2. 5	8 8. 8	8 5. 5	1 9. 0	0. 3 μm
実施例 22	< 0. 0 1	5 1. 4	9 0. 7	8 5. 2	1 5. 0	0. 3 μm
実施例 23	< 0. 0 1	5 8. 4	8 0. 1	7 4. 3	2 7. 4	1. 5 μm
実施例 24	< 0. 0 1	5 0. 5	8 9. 6	8 3. 1	1 8. 8	0. 3 μm
実施例 25	< 0. 0 1	4 9. 2	9 0. 1	8 4. 1	1 3. 5	0. 3 μm
実施例 26	< 0. 0 1	4 8. 7	9 0. 0	8 3. 0	1 3. 8	0. 3 μm
比較例 4	0. 1 1	7 2. 3	7 5. 2	3 9. 1	4 2. 3	2. 5 μm
比較例 5	< 0. 0 1	8 2. 7	8 9. 3	2 4. 3	7. 8	0. 6 μm
比較例 6	< 0. 0 1	7 8. 1	8 0. 4	3 6. 3	3 1. 9	1. 5 μm

註：全光線透過率の単位は、%である。

[実施例 2 7]

(偏光板の作製)

実施例 2 5 で調製した偏光選択層用塗布液をダイを用いてバンド流延、乾燥し、厚み 4 0 μm となるようにした。このフィルムをバンドから剥ぎ取り、ドライで 2 5 $^{\circ}\text{C}$ にて 1. 2 倍延伸した。次いで既に 6 倍に延伸されたヨウ素吸着したポリビニルアルコールフィルムと圧着のみのよってラミネートし、そのフィルムをホウ酸 1 0 0 g / l の水溶液中に 7 0 $^{\circ}\text{C}$ にて 5 分間浸漬し、さらに水洗槽で 2 0

℃、10秒間水洗して、さらに80℃で5分間乾燥し、そのままケン化したセルローストリアセテートフィルム（富士写真フィルム（株）製）にポリビニルアルコール（PVA117、クラレ（株））5質量%水溶液を糊として両面をラミネートした。このフィルムを120℃で乾燥し、偏光板を作製した。

（偏光板の評価）

実施例26で作製した偏光板、実施例27で作製した偏光板、および市販の（光吸収型偏光素子のみからなる）偏光板を、アルミニウムでできた反射板の上に偏光選択層を反射板側にして置いて観察したところ、実施例26および27で作製した偏光板の方が反射板が明るく見えた。これは外光が反射板で反射し、反射光が光散乱型偏光素子の偏光選択層において透過軸の偏光のみ透過し、後方散乱した光が再度反射板で反射して光散乱型偏光素子の偏光選択層に到達することによって光の利用効率が上がったことを示している。

なお、実施例26および27で作製した偏光板を40℃、80%RHの高湿下にて3日間保存したところ、実施例26で作製した偏光板は輝度上昇効果が小さくなったのに対し、実施例27で作製した偏光板は変化がなかった。

〔実施例28〕

（液晶表示装置の作製）

実施例25で作製した光散乱型偏光素子を用いて、図3に示す構造の液晶表示装置を作製した。

〔実施例29〕

（液晶表示装置の作製）

実施例27で作製した偏光板を用いて、図4に示す構造の液晶表示装置を作製した。

（液晶表示装置の評価）

実施例28および29で作製した液晶表示装置では、正面だけでなく斜めから

見たときも明らかに輝度の上昇が見られた。

請 求 の 範 囲

1. 所定の偏光を選択的に透過し他の偏光を選択的に反射または散乱する偏光選択層を有する光散乱型偏光素子と、所定の偏光を選択的に透過し他の偏光を選択的に吸収する偏光選択層を有する光吸収型偏光素子とが積層されており、光散乱型偏光素子の偏光透過軸と光吸収型偏光素子の偏光透過軸とが実質的に平行となるように配置されており、そして、光散乱型偏光選択素子の偏光選択層が光学的等方性連続相と光学的異方性不連続相とからなることを特徴とする偏光板。

2. さらに、少なくとも一枚の透明支持体を有する請求の範囲第1項に記載の偏光板。

3. 偏光選択層の面内の方向において、光学的等方性連続相の屈折率と、光学異方性不連続相の屈折率との差の最小値が0.05未満である請求の範囲第1項に記載の偏光板。

4. 光学的等方性連続相が、高分子化合物を含む請求の範囲第1項に記載の偏光板。

5. 光学的異方性不連続相が、0.01乃至10 μm の平均径を有する請求の範囲第1項に記載の偏光板。

6. 光学的異方性不連続相が、液晶性化合物を含む請求の範囲第1項に記載の偏光板。

7. 光学的異方性不連続相が、重合性基を有する液晶性化合物の重合生成物を含む請求の範囲第1項に記載の偏光板。

8. 光学的異方性不連続相が、光配向性官能基を有する化合物を含む請求の範

図第 1 項に記載の偏光板。

9. 光配向性官能基を有する化合物を含む不連続相に光照射することにより、光学的異方性不連続相が形成されている請求の範囲第 1 項に記載の偏光板。

10. 光散乱型偏光素子の偏光選択層の面に垂直な偏光面において、最大の全光線透過率が 75%以上であり、かつ最小の全光線透過率が 60%未満である請求の範囲第 1 項に記載の偏光板。

11. 光吸収型偏光素子の偏光度が 99%以上である請求の範囲第 1 項に記載の偏光板。

12. 透明支持体が、セルローストリアセテートフィルムからなる請求の範囲第 2 項に記載の偏光板。

13. セルローストリアセテートフィルムが、ハロゲン化炭化水素を溶媒として実質的に使用せずに製造されたフィルムである請求の範囲第 12 項に記載の偏光板。

14. さらに、ディスコティック化合物からなる光学異方層を有し、光学異方層、光吸収型偏光素子、そして光散乱型偏光素子の順に積層されている請求の範囲第 1 項に記載の偏光板。

15. バックライト、偏光板、ツイストネマチック配向モードの液晶セル、そして偏光板が、この順に積層されている液晶表示装置であって、バックライト側の偏光板が、バックライト側から順に、所定の偏光を選択的に透過し他の偏光を選択的に反射または散乱する偏光選択層を有する光散乱型偏光素子と、所定の偏光を選択的に透過し他の偏光を選択的に吸収する偏光選択層を有する光吸収型偏光素子とが積層されており、光散乱型偏光素子の偏光透過軸と光吸収型偏光素子

の偏光透過軸とが実質的に平行となるように配置されており、そして、光散乱型偏光選択素子の偏光選択層が光学的等方性連続相と光学的異方性不連続相とからなる液晶表示装置。

16. バックライト側の偏光板が、バックライト側から順に、上記の光散乱型偏光素子、上記の光吸収型偏光素子、透明支持体、そして、ディスコティック化合物からなる光学異方性層が積層されている請求項15に記載の液晶表示装置。

17. バックライト、偏光板、ベンド配向モードの液晶セル、そして偏光板が、この順に積層されている液晶表示装置であって、バックライト側の偏光板が、バックライト側から順に、所定の偏光を選択的に透過し他の偏光を選択的に反射または散乱する偏光選択層を有する光散乱型偏光素子と、所定の偏光を選択的に透過し他の偏光を選択的に吸収する偏光選択層を有する光吸収型偏光素子とが積層されており、光散乱型偏光素子の偏光透過軸と光吸収型偏光素子の偏光透過軸とが実質的に平行となるように配置されており、そして、光散乱型偏光選択素子の偏光選択層が光学的等方性連続相と光学的異方性不連続相とからなる液晶表示装置。

18. バックライト側の偏光板が、バックライト側から順に、上記の光散乱型偏光素子、上記の光吸収型偏光素子、透明支持体、そして、ディスコティック化合物からなる光学異方性層が積層されている請求項17に記載の液晶表示装置。

19. バックライト、偏光板、水平配向モードの液晶セル、そして偏光板が、この順に積層されている液晶表示装置であって、バックライト側の偏光板が、バックライト側から順に、所定の偏光を選択的に透過し他の偏光を選択的に反射または散乱する偏光選択層を有する光散乱型偏光素子と、所定の偏光を選択的に透過し他の偏光を選択的に吸収する偏光選択層を有する光吸収型偏光素子とが積層されており、光散乱型偏光素子の偏光透過軸と光吸収型偏光素子の偏光透過軸とが実質的に平行となるように配置されており、そして、光散乱型偏光選択素子の

偏光選択層が光学的等方性連続相と光学的異方性不連続相とからなる液晶表示装置。

20. バックライト側の偏光板が、バックライト側から順に、上記の光散乱型偏光素子、上記の光吸収型偏光素子、透明支持体、そして、ディスコティック化合物からなる光学異方性層が積層されている請求項19に記載の液晶表示装置。

21. 透明支持体上に、所定の偏光を選択的に透過し、他の偏光を選択的に反射または散乱する偏光選択層が形成されている光学フィルムであって、偏光選択層が光学的等方性連続相と光学的異方性不連続相とからなり、フィルム面に垂直な偏光面において、最大の全光線透過率が75%以上であり、最小の全光線透過率が60%未満であることを特徴とする光学フィルム。

22. フィルム面内の方向において、光学的等方性連続相と光学的異方性不連続相との最小の屈折率差が0.05未満である請求の範囲第21項に記載の光学フィルム。

23. 光学的異方性不連続相が、液晶性化合物を含む請求の範囲第21項に記載の光学フィルム。

24. 液晶性化合物が、0.10以上の固有複屈折を有する請求の範囲第23項に記載の光学フィルム。

25. 光学的異方性不連続相が、重合性基を有する液晶性化合物の重合生成物を含む請求の範囲第21項に記載の光学フィルム。

26. 光学的異方性不連続相が、1.0 μm 以下の平均粒径を有する請求の範囲第21項に記載の光学フィルム。

27. 偏光選択層が、3.0倍以下の延伸により形成されている請求の範囲第21項に記載の光学フィルム。

図 1

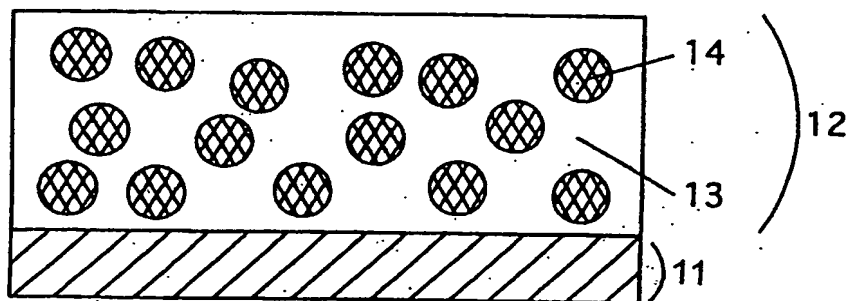


図 2

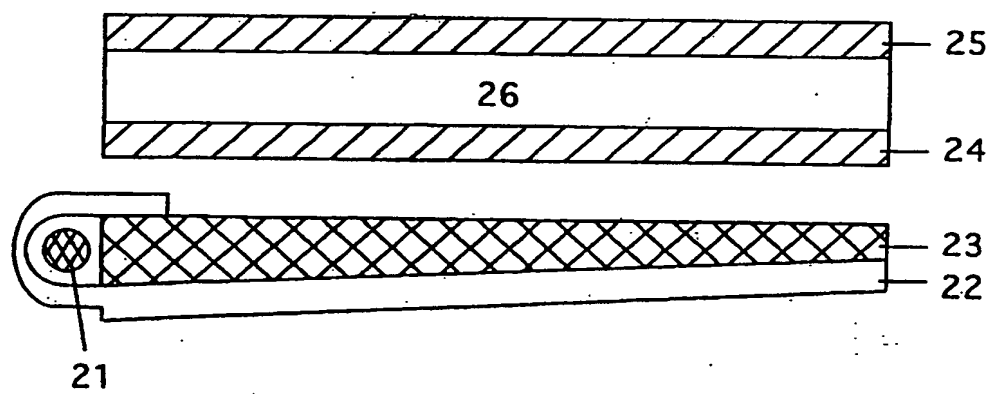


図 3

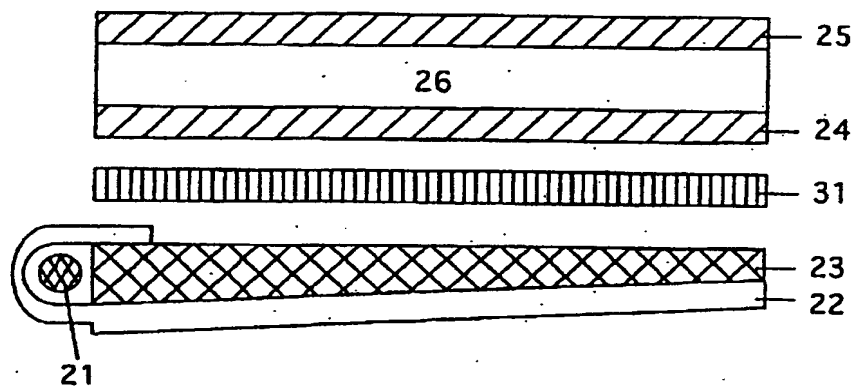


図 4

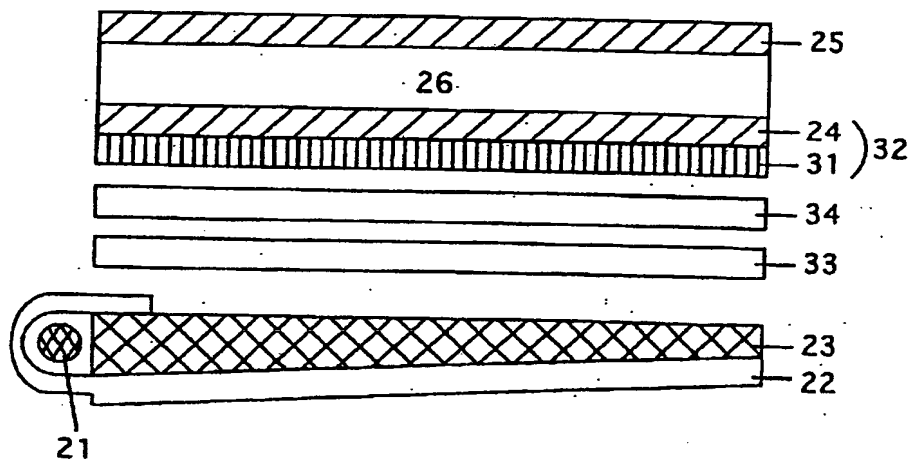
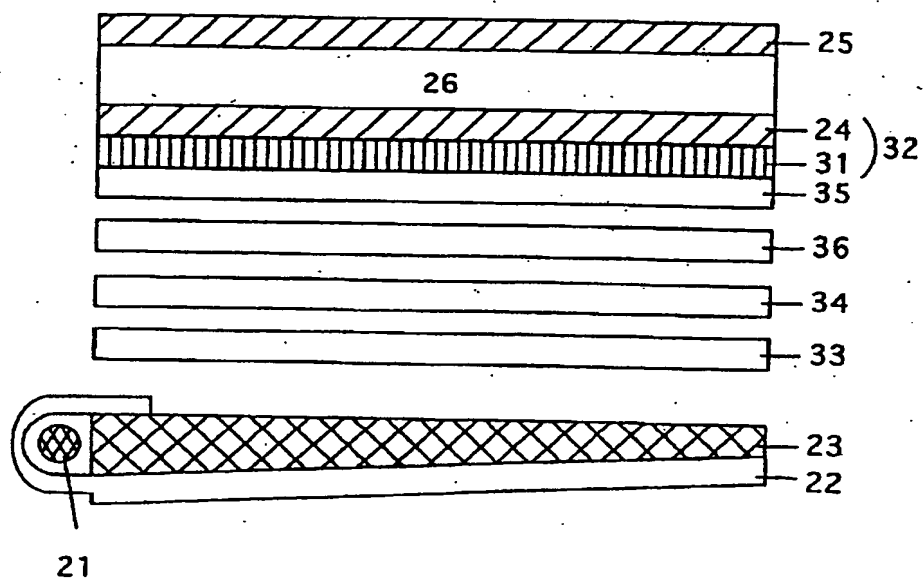


図 5



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/00563

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ G02B5/30, G02F1/1335

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ G02B5/30, G02F1/1335

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2001

Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2001

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP, 11-174211, A (Nitto Denko Corporation), 02 July, 1999 (02.07.99), Claim 5; Columns 2 to 7; examples 2, 3 (Family: none)	1-26
X	JP, 11-326610, A (Nitto Denko Corporation), 26 November, 1999 (26.11.99), Claim 4; examples 1, 2 (Family: none)	1-26
X	JP, 9-274108, A (Teijin Limited), 21 October, 1997 (21.10.97), Claim 8; Par. Nos. [0042]~[0043] (Family: none)	1-26
X Y	EP, 506176, A1 (N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken), 30 September, 1992 (30.09.92), Claims 1-5 & JP, 5-72416, A Claim 1-5; Par. Nos. [0007] to [0010] & US, 5204763, A & DE, 69208125, E	21-25 26

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	understand the principle or theory underlying the invention
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	"&" document member of the same patent family
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search
27 April, 2001 (27.04.01)

Date of mailing of the international search report
15 May, 2001 (15.05.01)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/00563

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP, 5-45519, A (Fujitsu Limited), 23 February, 1993 (23.02.93), Claim 3; all drawings (Family: none)	21-26
Y	JP, 9-158719, A (Mitsubishi Chemical Corporation), 20 June, 1997 (20.06.97), Full text; all drawings (Family: none)	8,9

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G02B5/30, G02F1/1335

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G02B5/30, G02F1/1335

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2001年
 日本国登録実用新案公報 1994-2001年
 日本国実用新案登録公報 1996-2001年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	J P, 11-174211, A (日東電工株式会社) 2. 7月. 1999 (02. 07. 99) 請求項5、第2欄~第7欄、実施例2、及び実施例3 (ファミリーなし)	1-26
X	J P, 11-326610, A (日東電工株式会社) 26. 11月. 1999 (26. 11. 99) 請求項4、及び実施例1乃至2 (ファミリーなし)	1-26

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

27. 04. 01

国際調査報告の発送日

15.05.01

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)
 郵便番号100-8915
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

里村 利光

2V 9314

電話番号 03-3581-1101 内線 3271

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	J P, 9-274108, A (帝人株式会社) 21. 10月. 1997 (21. 10. 97) 請求項8、及び段落【0042】～【0043】 (ファミリーなし)	1-26
X Y	EP, 506176, A1 (N.V.Philips' Gloeilampenfabrieken) 30. 9月. 1992 (30. 09. 92) Claims1.-5. & J P, 5-72416, A, 請求項1乃至5、段落【0007】～ 【0010】 & US, 5204763, A & DE, 69208125, E	21-25 26
Y	J P, 5-45519, A (富士通株式会社) 23. 2月. 1993 (23. 02. 93) 請求項3、全図 (ファミリーなし)	21-26
Y	J P, 9-158719, A (三菱化学株式会社) 20. 6月. 1997 (20. 06. 97) 全文、全図 (ファミリーなし)	8, 9